Bildung siliciumorganischer Verbindungen. XXXIX

Teilchlorierte Carbosilane

Von G. Fritz und H. Fröhlich

Mit 4 Abbildungen

Professor Rudolf Scholder zum 75. Geburtstage am 15. Juni 1971 gewidmet

Inhaltsübersicht. 1. Die Photochlorierung der Si-chlorierten Carbosilane (Cl₃Si-CH₂)₂SiCl₂ und (Cl₂Si-CH₂)₃ führt in CCl₄ zu den vollchlorierten Verbindungen: z.B. (Cl₃Si-CCl₂)₂SiCl₂. Die an einer CH₂-Gruppe begonnene Chlorierung führt bevorzugt zur CCl₂-Gruppe, bevor eine weitere in die Reaktion einbezogen wird. Dadurch wird die präparative Darstellung der Verbindungen a, b, c möglich. Cl₃Si-CCl₂-SiCl₂-CH₂-SiCl₃ (a)

Die Chlorierung mit SO₂Cl₂ (Benzoylperoxid) verläuft langsamer und ermöglicht den Zugang zu CHCl-haltigen Carbosilanen wie (d), Cl₃Si—CHCl—SiCl₂—CH₂—SiCl₃ (e). Die Umsetzung der Verbindungen (a) bis (d) mit LiAlH₄ führt zu SiH-haltigen, C-teilchlorierten Carbosilanen.

2. Die hohe Reaktionsfähigkeit der ≡Si-CCl₂-Si≡ Gruppen ermöglicht den Austausch von Cl-Atomen der CCl-Gruppe in perchlorierten — mit H-Atomen der Si-H-Gruppen in perhydrierten Carbosilanen und gibt damit den Zugang zu CHCl- und SiHCl-haltigen Verbindungen; z.B. nach

$$\begin{aligned} &(\text{Cl}_3\text{Si}-\text{CCl}_2)_2\text{SiCl}_2 + (\text{H}_3\text{Si})_2\text{CH}_2 \rightarrow \text{Cl}_3\text{Si}-\text{CHCl}-\text{SiCl}_2-\text{CCl}_2-\text{SiCl}_3 \\ &+ \text{H}_2\text{ClSi}-\text{CH}_2-\text{SiH}_3. \end{aligned}$$

Es werden folgende Umsetzungen angegeben:

$$\begin{split} &(\text{Cl}_3\text{Si})_2\text{CCl}_2 + (\text{H}_3\text{Si})_2\text{CH}_2; \ (\text{Cl}_3\text{Si} - \text{CCl}_2)_2\text{SiCl}_2 + (\text{H}_3\text{Si} - \text{CH}_2)_2\text{SiH}_2; \\ &(\text{Cl}_3\text{Si} - \text{CCl}_2)_2\text{SiCl}_2 + (\text{H}_3\text{Si})_2\text{CH}_2; (\text{Cl}_2\text{Si} - \text{CCl}_2)_3 + (\text{H}_3\text{Si} - \text{CH}_2)_2\text{SiH}_2; \\ &(\text{Cl}_3\text{Si} - \text{CCl}_3)_3 + (\text{H}_2\text{Si} - \text{CH}_2)_3 \end{split}$$

und die Umlagerung von H₃Si-CHCl-SiH₃ beschrieben.

Abstract. 1. Photochlorination in $\mathrm{CCl_4}$ of the Si-chlorinated carbosilanes $(\mathrm{Cl_3Si-CH_2})_2\mathrm{SiCl_2}$ and $(\mathrm{Cl_2Si-CH_2})_3$ leads to totally chlorinated compounds, e. g. $(\mathrm{Cl_3Si-CCl_2})_2\mathrm{SiCl_2}$. After chlorination has started at one $\mathrm{CH_2}$ group, formation of a $\mathrm{CCl_2}$ group is preferred beford another $\mathrm{CH_2}$ group is involved into the reaction. Thus preparation of compounds a, b, c is possible. $\mathrm{Cl_3Si-CCl_2-SiCl_2-CH_2-SiCl_3}$ (a) for (b) and (c) (see "Inhaltsübersicht").

 SO_2Cl_2 (benzoyl peroxide) as chlorinating agent reacts more slowly, and opens an access to carbosilanes containing CHCl groups such as (d), $Cl_3Si-CHCl-SiCl_2-CH_2-SiCl_3$ (e). Reactions of compounds (a) to (d) with $LiAlH_4$ yields carbosilanes with SiH groups, and partially chlorinated C atoms.

2. By the high reactivity of Si-CCl₂-Si groups an exchange of Cl atoms of CCl groups in perchlorinated carbosilanes is possible for H atoms of Si-H groups in perhydrogenated carbosilanes, thus allowing the preparation of compounds containing CHCl and SiHCl groups, e. g. according to Gl.(1) (Inhaltsübersicht).

Further reactions, formulated as the last equations in Inhaltsübersicht, are reported as well as the rearrangement of $\mathbf{H_3Si-CHCl-SiH_3}$.

In der Chemie der Carbosilane ergeben sich beim Molekülgerüst des 1,3-Disilapropans durch Zuordnung der Cl- und H-Atome die Verbindungen 1—4, wobei die Teilchlorierung einer Gruppe ausgeschlossen wird.

$$1.~\mathrm{Cl_3Si-CH_2-SiCl_3}\qquad 3.~\mathrm{H_3Si-CH_2-SiH_3}$$

Diese Verbindungen sind bekannt¹)²)³). Sie haben sehr unterschiedliche chemische Eigenschaften. Die Zahl der Verbindungen wird größer, wenn Teilchlorierungen an C- bzw. Si-Atom zugelassen werden; Beispiel 5, 6, 7.

5.
$$Cl_3Si-CHCl-SiCl_3$$
 6. $H_3Si-CHCl-SiH_3$

7.
$$H_{3-n}Cl_nSi-CH_2-SiH_{3-n}Cl_n$$
 (n = 1-3).

Entsprechendes gilt für die Derivate des $(Cl_3Si-CH_2)_2SiCl_2$ und $(Cl_2Si-CH_2)_3$.

Dazu kommt bei Derivaten mit drei und mehr Si-Atomen die Möglichkeit des unterschiedlichen Einbaues dieser Gruppen im Carbosilan-Gerüst, wie die Beispiele 8—11 zeigen, in denen noch von einer unterschiedlichen Substitution am Si-Atom (H bzw. Cl) abgesehen wird.

8.
$$\equiv$$
Si-CHCl-Si-CH₂-Si \equiv 10. \equiv Si-CHCl-Si-CCl₂-Si \equiv 9. \equiv Si-CCl₂-Si \equiv 11. \equiv Si-CHCl-Si-CHCl-Si

¹⁾ G. FRITZ, J. GROBE u. D. KUMMER, Adv. Inorg. Chem. and Radiochem. 7, 349 (1965).

²) G. Fritz, G. Teichmann u. D. Habel, Z. anorg. allg. Chem. 303, 85 (1960).

³⁾ G. Fritz, H. Fröhlich u. D. Kummer, Z. anorg. allg. Chem. 353, 34 (1967).

Der Zugang zu Verbindungen dieser Typen ist von allgemeinerem Interesse, nachdem in letzter Zeit sehr komplexablaufende Umsetzungen perchlorierter Derivate wie (Cl₃Si)₂CCl₂, (Cl₃Si—CCl₂)₂SiCl₂ und (Cl₂Si—CCl₂)₃ mit CH₃MgCl beobachtet wurden ⁴)⁵)⁶). Für die weitere Untersuchung dieser Reaktionen ist der Zugang zu teilchlorierten Carbosilanen erforderlich. Es wird über deren Bildung berichtet ⁶).

Wie früher mitgeteilt, lassen sich die reaktionsträgen CH₂-Gruppen in Carbosilanen durch Photochlorierung in CCl₂-Gruppen überführen. Endprodukte dieser Umsetzung sind die perchlorierten Carbosilane²)⁷). Die Bildung teilchlorierter Verbindungen mit Cl-Gruppen wird bei den Verbindungen (Cl₃Si)₂CH₂ (Cl₃Si—CH₂)₂SiCl₂ und (Cl₂Si—CH₂)₃ mit steigender Zahl der CH₂-Gruppen schwieriger. Die Darstellung einer CHCl-haltigen Verbindung durch Photochlorierung in präparativem Maßstabe ist nur beim (Cl₃Si)₂CHCl möglich⁵), weil hier die Reaktion in der Gasphase durchgeführt werden kann und eine nennbare Siedepunktsdifferenz zwischen der CH₂-und CHCl-haltigen Verbindung besteht.

I. Die Bildung C-teilchlorierter, Si-chlorierter Carbosilane

1. Chlorierung des (Cl₃Si—CH₂)₂SiCl₂ [2]. Die Photochlorierung von [2]⁸) verläuft in CCl₄ schneller als ohne Lösungsmittel. Anhaltspunkte über die Bildung teilchlorierter Produkte und damit über den Chlorierungsablauf werden mit Hilfe der PMR-Spektren erhalten, die in bestimmten Zeitabständen vom Chlorierungsprodukt aufgenommen wurden. Die Untersuchung zeigt, daß die Verbindungen Cl₃Si—CHCl—SiCl₂—CH₂—SiCl₃ [5], Cl₃Si—CCl₂—SiCl₂—CH₂—SiCl₃ [6] und Cl₃Si—CCl₂—SiCl₂—CHCl—SiCl₃ [7] als Zwischenprodukte auftreten, von denen [5] nur am Anfang und [7] erst dann gebildet wird, wenn die Ausgangsverbindung [2] völlig verbraucht ist. Lediglich die Verbindung [6] ist bei der Chlorierung über einen größeren Zeitraum im Reaktionsgemisch vorhanden. Aus dem Fehlen von (Cl₃Si—CHCl)₂SiCl₂ [8] im Reaktionsgemisch und dem längeren Auftreten von [6] folgt, daß die Chlorierung über Verbindung [6] läuft. Eine bereits gebildete CHCl-Gruppe wird schneller weiterchloriert als eine intakte CH₂-Gruppe angegriffen. Der absolute Anteil der Verbindungen [5], [6], [7] im

⁴) G. Fritz u. N. Szczepanski, Angew. Chem. **79**, 1067 (1967); Z. anorg. allg. Chem. **367**, 44 (1969); G. Fritz u. J. Grobe, Z. anorg. allg. Chem. **309**, 77 (1961); G. Fritz u. E. Bosch, Z. Naturforsch. **25b**, 1313 (1970).

⁵) G. Fritz, P. Böttinger, N. Braunagel, R. Riekens, T. Günther, u. P. Hofmann, unveröffentlicht.

⁶⁾ G. Fritz u. H. Fröhlich, Z. Naturforsch. 25b, 1311 (1970).

⁷) R. MÜLLER u. G. SEITZ, Chem. Ber. **91**, 22 (1958).

⁸⁾ Die Verbindungen haben im Text und in den Tab. jeweils die gleiche Nr. [].

Reaktionsgemisch ist nicht anzugeben, da die vollehlorierte Verbindung (Cl₃Si—CCl₂)₂SiCl₂ [9] kein Signal im PMR-Spektrum gibt. Aus der Integration des PMR-Spektrums ergibt sich jeweils das relative Verhältnis von [5]:[6]:[7], wobei [7] in geringster Menge auftritt. Bei dem rechtzeitigen Abbrechen der Chlorierungsreaktion ist Verbindung [6] präparativ faßbar. Die Photochlorierung in der Gasphase, die beim (Cl₃Si)₂CH₂ [1] zur Teilchlorierung führt, ist beim (Cl₃Si—CH₂)₂SiCl₂ [2] wegen des hohen Siedepunktes von [2] und der relativ geringen Siedepunkts-Unterschiede zu den Chlorierungsprodukten nicht mehr vorteilhaft.

Die teilweise Chlorierung von [2] mit SO_2Cl_2 unter Verwendung von Benzoylperoxid führte zur Bildung der Verbindungen [6] und [7]; etwa im gleichen Molverhältnis. Dabei wurden 60% der Ausgangsverbindung [2] umgesetzt. Verbindung [5] und [6] sind u. a. durch die PMR-Spektren in Tab. 6 charakterisiert.

2. Chlorierung des (Cl₂Si—CH₂)₃ [3]. Durch das Vorliegen von 3 CH₂-Gruppen in der Molekel werden die Möglichkeiten bei der Teilchlorierung erhöht. Der Ablauf der Chlorierung ist ebenfalls über das PMR-Spektrum kontrollierbar. Die Photochlorierung des (Cl₂Si—CH₂)₃ in CCl₄ führt zum vollehlorierten Endprodukt (Cl₂Si—CCl₂)₃ [12].

Bei der Verfolgung der Photochlorierung über die PMR-Spektren ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei Verbindung [2]. Zu Beginn der Chlorierung entstehen neue Absorptionslinien zwischen 92,5 und 102 Hz, sowie zwischen 194 und 209 Hz neben den Signalen der Ausgangsverbindung [3] bei 86,5 Hz. Im weiteren Verlauf der Umsetzung nimmt das Signal bei 86,5 Hz ständig ab. Während alle anderen Resonanzlinien in der Intensität nahezu gleich bleiben, wächst das bei 96 Hz ständig an und bleibt als einzig intensive Linie im Chlorierungsgemisch erhalten, solange von der Ausgangsverbindung noch eine schwache Absorption zu erkennen ist. Wird zu diesem Zeitpunkt die Chlorierungsreaktion abgebrochen, so läßt sich die kristalline Verbindung [10] mit einer Ausbeute um 60% isolieren. Die Identifizierung erfolgt auch über die Umsetzung mit LiAlH₄ und Isolierung der Verbindung [17], deren PMR-Spektrum aussagefähiger ist.

Die Fortsetzung der Chlorierungsreaktion ermöglicht die Einführung einer weiteren CCl₂-Gruppe in Verbindung [3], sodaß Verbindung [13] präparativ mit einer Ausbeute von 25% zugänglich wird 9).

Bei allen Photohalogenierungen wurden nie Signale der CHCl-Gruppe mit höherer Intensität beobachtet. Es ist daraus zu schließen, daß wie bei Verbindung [2] die einmal chlorierte CH₂-Gruppe schneller weiterreagiert als die Chlorierung einer neuen CH₂-Gruppe beginnt.

⁹⁾ G. FRITZ u. N. BRAUNAGEL, unveröffentlicht.

Um zu CHCl-haltigen Derivaten von [3] zu gelangen, muß die Chlorierung mit $\mathrm{SO_2Cl_2}$ durchgeführt werden. Bei Umsetzung von [3] mit $\mathrm{SO_2Cl_2}$ ($\mathrm{SO_2Cl_2}$ -Menge entspricht nur 2 der insgesamt 6 H-Atome in [3]), werden im PMR-Spektrum des Chlorierungsgemisches neben dem Signal der Ausgangsverbindung (86 Hz) Resonanzlinien bei 96 Hz (Verbindung [10]), 92 und 192,5 Hz sichtbar. Das Signal bei 192,5 Hz entspricht einer CHCl-, das bei 92 Hz einer CH₂-Gruppierung. Aus der Integration folgt ein CHCl:CH₂-Verhältnis von 1:4 und die Isolierung der Verbindungen nach Umsetzung mit LiAlH₄ zeigt, daß bei der Chlorierungsreaktion mit $\mathrm{SO_2Cl_2}$ die Verbindungen [10] und [11] gebildet wurden. Etwa 50% der eingesetzten Verbindung [3] wurden chloriert und die Chlorierungsprodukte bestanden zu 68% aus Verbindung [11] und zu 32% aus Verbindung [10].

II. Die Bildung C-teilchlorierter SiH-haltiger Carbosilane

Der Zugang zu C-teilchlorierten SiCl-haltigen Carbosilanen in Abschnitt I ermöglicht durch Umsetzung mit LiAlH₄ auch die Bildung der entsprechenden Si—H-haltigen, am Brücken-C-Atom teilchlorierten Carbosilane, wie es in Gl. (1) für Verbindung [4] angegeben wird. ([4] wurde aus (Cl₃Si)₂CH₂ [1] durch Photochlorierung in der Gasphase erhalten).

$$2 (\text{Cl}_3\text{Si})_2\text{CHCl} + 3 \text{LiAlH}_4 \rightarrow 2 (\text{H}_3\text{Si})_2\text{CHCl} + 3 \text{LiCl} + 3 \text{AlCl}_3.$$
 (1) [14]

Tabelle 1 C-teilchlorierte SiH-haltige Carbosilane

Entsprechend den Angaben für die Bildung von $(H_3Si)_3CCl_2^{10})$ wurde das $(H_3Si)_2CHCl$ [14] mit einer Ausbeute von 71% rein zugänglich. Daneben bilden sich nur geringe Mengen SiH_4 und $(H_3Si)_2CH_2$ [21]. In Tab. 1 sind die durch Umsetzung mit LiAlH₄ erhaltenen Carbosilane angegeben.

 $(H_3Si)_2$ CHCl [14] ist eine farblose Flüssigkeit (Molgewicht: gef. 108,3; 110 (Dampfdichte); ber. 110,5; Sdp. 63°C (extrapoliert aus der Dampfdruckkurve zwischen -32 und +18°C).

Dampfdruckmessung:

Die Struktur von [14] folgt unmittelbar aus dem PMR-Spektrum.

Die beiden gleichwertigen SiH₃-Gruppen werden durch die benachbarte CHCl-Gruppe zu einem Dublett (J=3,7 Hz) aufgespalten, dessen Mittelpunkt bei 235 Hz liegt. Erwartungsgemäß liegt diese SiH-Absorption zwischen der von $(H_3Si)_2CCl_2$ [22] und $(H_3Si)_2CH_2$ [21]. Das Zentrum des CHCl-Septetts (J=3,7 Hz) liegt bei 169 Hz im charakteristischen SiCHCl-Bereich; relatives Intensitätsverhältnis SiH:CH = 6:1. Die ²⁹SiH-Satelliten zeigen eine Aufspaltung in 2 Dubletts (J=3,7 Hz) mit einer Kopplungskonstante von 208,5 Hz. Bei höchster Auflösung wird eine Quartettstruktur sichtbar, die auf die Fernkopplung ²⁹SiH-CHCl-²⁸SiH zurückzuführen ist ($J=0,45\pm0,1$ Hz).

H₃Si—CHCl—SiH₂—CH₂—SiH₃ [15] und H₃Si—CCl₂—SiH₂—CH₂—SiH₃ [16]. Die Bildung von [15] und [16] durch Umsetzung der Chlorierungsprodukte von [2] mit LiAlH₄ sichert die Struktur der Verbindungen [5] und [6]. Die Umsetzung der SiCl-haltigen Derivate [5] und [6] mit LiAlH₄ verläuft ohne Schwierigkeiten und die Ausbeute der SiH-haltigen Verbindungen [15], [16] beträgt etwa 85% bezogen auf die SiCl-haltigen Ausgangsprodukte. [15] und [16] sind farblose Flüssigkeiten, die im Ölpumpenvakuum bei 20°C noch gut in eine mit flüssigem Stickstoff gekühlte Vorlage zu kondensieren sind. Eine vollständige Auftrennung des Gemisches durch fraktionierte Kondensation war nicht möglich; es gelang nur eine Anreicherung.

Abb.1 zeigt das PMR-Spektrum des Verbindungsgemisches [15], [16]. In 1a ist das Gesamtspektrum, in 1b der SiH-Bereich wiedergegeben. Das Spektrum zeigt die erwarteten Aufspaltungen.

$$^{(1)}_{\text{3}}$$
Si $-$ CHCl $-$ SiH $_{2}$ $-$ CH $_{2}$ $-$ SiH $_{3}$. [15]

Charakteristisch für [15] ist das CHCl-Multiplett (2) und das Dublett der SiH_3 -Gruppe (1).

- (1) wird durch (2) in ein Dublett (J=3,75~Hz) aufgespalten (Abb. 1b, w). Beide Linien sind relativ breit (Halbwertsbreite 0,8 Hz). Es kann mit Aufspaltungen durch (3) gerechnet werden, die aber nicht mehr auflösbar sind.
- (2) wird durch (1) in ein Quartett und dieses durch (3) weiter in ein Triplett aufgespalten. Wegen der nur wenig verschiedenen Kopplungskonstanten (3,75 und 3,5 Hz) ist (Abb. 1 a, x)

¹⁰) G. Fritz u. H. Fröhlich, Z. anorg. allg. Chem. 382, 9 (1971).

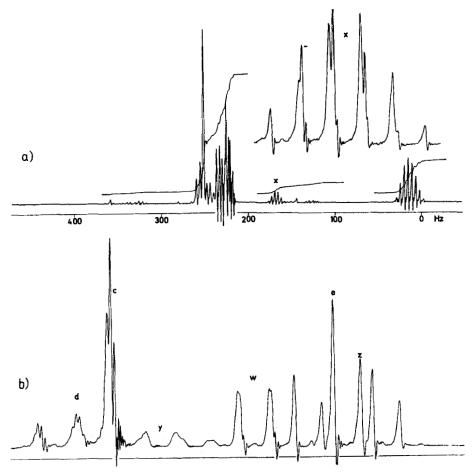


Abb. 1. PMR-Spektrum von $H_3Si-CHCl-SiH_2-CH_2-SiH_3$ [15] + $H_3Si-CCl_2-SiH_2-CH_2-SiH_3$ [16]. a) Übersichtsspektrum und CHCl-Bereich bei 50 Hz; b) SiH-Bereich bei 50 Hz, in CCl_4 : 60 MHz

ein 6-Linienmultiplett zu sehen, das bei höchster Auflösung weiter aufspaltet und sich mit einem aus beiden Kopplungskonstanten aufgezeichneten "Aufspaltungsschema" deckt.

- (3) wird durch (2) in ein Dublett und dessen beide Linien werden durch (4) weiter in ein Triplett aufgespalten, so daß ein 6-Linienmultiplett entsteht. Wie aus einem Aufspaltungsschema zu erkennen ist, fallen die 4 mittleren Linien zu zwei breiten Absorptionen zusammen, so daß ein 4 Linienmultiplett sichtbar wird (Abb.1b, y; eine Absorption wird durch die SiH₃-Gruppe von [16] verdeckt), aus dem die Kopplungskonstanten (2)—(3) zu 3,5 Hz und (3)—(4) zu 4,3 Hz entnehmbar sind.
- (4) zeigt das aus (5) und (3) resultierende sichtbare 6-Linienmultiplett der SiH $_3$ -CH $_2$ -SiH $_2$ -Gruppierung.
 - (5) hat die durch (4) verursachte Triplettstruktur (Abb. 1b, z).

Die chemischen Verschiebungen der einzelnen Gruppen (Mittelpunkte der Multipletts) sind

(1) 233.5 Hz; (2) 166.5 Hz; (3) 243.5 Hz; (4) 4.3 Hz; (5) 220.5 Hz.

$$\mathbf{H_{3}Si-CCl_{2}-SiH_{2}-CH_{2}-SiH_{3}}^{(1)}$$
 [16]

Charakteristisch für [16] sind die Resonanzlinien von (1) und (2).

(1) zeigt das für die $SiH_3-CCl_2-SiH_2$ -Gruppierung typische Bild, das schon beim $H_3Si-CCl_2-SiH_2-CH_3^{10}$) und beim $H_3Si-CCl_2-SiH_2-CCl_2-SiH_3$ gefunden wurde. Die Absorptionslinie der SiH_3 -Gruppe erscheint bei höchster Auflösung als Triplett (Fernkopplung mit (2)); Abb. 1 b, c.

$$J_{S1H_{\bullet}-CC1,-S1H_{\bullet}} = 0.4 \pm 0.1 \text{ Hz}.$$

- (2) wird durch (3) in ein Triplett aufgespalten mit J=4,4 Hz, dessen eine Außenlinie mit (1) zusammenfällt. Die Fernkopplung über die $\mathrm{CCl_2}$ -Gruppe mit (1) bewirkt eine weitere Aufspaltung der Triplettlinien in ein nicht mehr vollständig aufgelöstes Quartett (J=0,4 Hz, s. Abb.1b, d).
- (3) Hier wird ein 6-Linienmultiplett gefunden, das für die $SiH_3-CH_2-SiH_2-Gruppierung$ erwartet wird.
 - (4) zeigt das durch (3) verursachte Triplett, J = 4,5 Hz (Abb. 1b, e).

Die chemischen Verschiebungen:

(Es wurden die Zentren der Multipletts ausgemessen).

Die ²⁹SiH-Satelliten von (1) und (4) haben eine Kopplungskonstante von:

(1)
$$J_{29S1H_2} = 215 \text{ Hz}$$
; (4) $J_{29S1H_2} = 201,5 \text{ Hz}$.

Die Summenformel von [16] wurde durch die massenspektrometrische Untersuchung bestätigt (Tab. 5).

Die Umsetzung von Verbindung [10] mit LiAlH₄ führt zu Verbindung [17], die bereits um 0°C auskristallisiert und mit einer Ausbeute von mehr als 60% erhalten werden kann. [17] ist durch das PMR-Spektrum (Tab. 6) und die massenspektrometrische Untersuchung gesichert. Das PMR-Spektrum Abb. 2 zeigt zwei Multipletts im SiH- und SiCH-Bereich, die bei höchster Auflösung nicht aus scharfen Einzellinien, sondern aus relativ breiten Absorptionsbanden bestehen, wie bei den ringförmigen Verbindungen beobachtet wird¹); relatives Intensitätsverhältnis SiH:CH = 6:4. Die SiH-Protonen zeigen eine Aufteilung im relativen Intensitätsverhältnis 12,8:6,2, sodaß 4 Protonen bei niederem Feld (Triplettstruktur) und 2 Protonen bei höherem Feld (Quintettstruktur) erscheinen. Bei höchster Auflösung des Multipletts ist zu erkennen, daß neben der HSi-CH-Kopplung der benachbarten Gruppen, die zu den erwarteten Quintett und Triplett-Strukturen führt, noch weitere Kopplungen in der ringförmigen Verbindung vorliegen. Die Multipletts bestehen nicht aus scharfen Einzellinien; sie setzen sich aus breiten Absorptionsbanden zusammen und besitzen teilweise eine noch nicht zu deutende Feinstruktur.

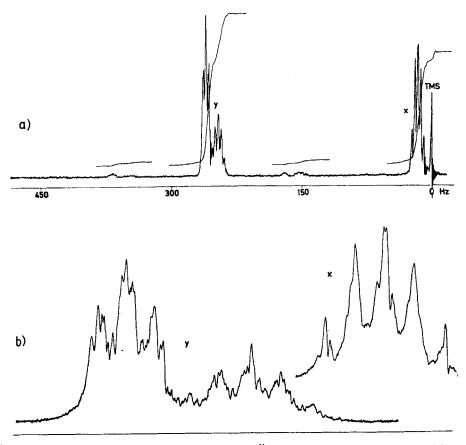


Abb. 2. PMR-Spektrum von Verbindung [17]. a) Übersichtsspektrum; b) SiH- und CH-Multipletts bei 50 Hz, in CCl₄: 60 MHz

Die Chlorierung von $(Cl_2Si-CH_2)_3$ [3] mit SO_2Cl_2 führt zum Gemisch der Verbindungen [10] und [11], bei deren Umsetzung mit LiAl H_4 neben $(H_2Si-CH_2)_3$ die Verbindungen [17] und [18] entstehen.

Die Formeln $\mathrm{Si_3C_3H_{10}Cl_2}$ [17] und $\mathrm{Si_3C_3H_{11}Cl}$ [18] werden durch massenspektrometrische Untersuchung gesichert. Die Strukturformeln werden durch das PMR-Spektrum bestätigt. Das PMR-Spektrum zeigt besonders auffällig ein nicht aufgelöstes breites Absorptionssignal bei 171 Hz im CHCl-Bereich (Halbwertsbreite 6 Hz) sowie zwei Multiplett im SiCH₂- und ein weiteres im SiH₂-Bereich. Das bei tieferem Feld gelegene CH₂-Multiplett (Quintettstruktur) ist der Verbindung [17] zuzuordnen.

Die SiH-Resonanzen sind nicht auflösbar. Das Multiplett im CHCl-Bereich bei 171 Hz ist durch Verbindung [18] bedingt. Für die SiH $_2$ -Multipletts von [18] ist zu erwarten, daß sie bei etwas höherem Feld als die von Verbindung [17] liegen. Die Spitze des Multipletts

¹⁵ Z. anorg. allg. Chemie. Bd. 382.

erscheint bei 253 Hz. Da das CHCl-Signal bei 171 Hz von einem Proton von [18] hervorgerufen wird, lassen sich die SiH- und CH-Intensitäten der anderen Protonen berechnen und von dem im Spektrum gefundenen Werten subtrahieren. Die Differenz ergibt ein SiH:CH-Verhältnis von 6:4, das dem der Verbindung [17] entspricht.

Der Anteil der beiden Verbindungen im Gemisch läßt sich somit angeben zu [18] (60 Mol-%), [17] (40 Mol-%). Verbindung [19] (Smp. 20—22°C) wird mit einer Ausbeute vom 90% durch Umsetzung von [13] mit LiAlH₄ erhalten⁹). Das PMR-Spektrum Tab. 6) bestätigt die Strukturformel.

III. Umsetzungen perchlorierter mit perhydrierten Carbosilanen zur Bildung teilchlorierter Derivate

Die hohe Reaktionsfähikeit der CCl₂-Gruppe in den perchlorierten Carbosilanen ermöglicht einen leichten Austausch der CCl- gegen die SiH-Gruppe entsprechend Gl. (2), der sich zur Darstellung teilchlorierter Carbosilane ausnutzen läßt.

$$\equiv SiH + \equiv CCl \rightarrow \equiv SiCl + \equiv CH.$$
 (2)

Diese Austauschreaktion zwischen der SiH- und CCl-Gruppe wird auch in Lösungen von Silanen in CCl₄ beobachtet ¹¹), jedoch vollziehen sich diese Umsetzungen bei einfachen Triorganosilanen erst unter Zusatz von Katalysatoren ¹²) oder bei UV-Bestrahlung in der Gasphase ^{13,14}). Beim Erwärmen einer benzolischen Lösung von (H₂Si—CH₂)₃ und (Cl₂Si—CCl₂)₃ auf 100 °C war eine vollständige Umsetzung der SiH-haltigen Verbindung zu beobachten. Dabei entstehen nach dem PMR-Spektrum Verbindungen mit SiHCl- und CHCl-Gruppen ¹⁵). Diese Austauschreaktion zwischen vollhydrierten und vollchlorierten Carbosilanen ist nicht auf die cyclischen Verbindungen beschränkt.

1. Reaktion zwischen $(Cl_8Si)_2CCl_2$ [20] und $(H_3Si)_2CH_2$ [21]

Die Umsetzung zwischen den Verbindungen [20] und [21] im Molverhältnis 3:2 führt innerhalb von 15 Tagen zu einer 86proz. Chlorierung von [21]. SiH-haltige Zersetzungsprodukte wie SiH₄ werden nicht beobachtet; es erfolgt keine Spaltung der Si—C-Bindung. In Tab. 2 sind die Reaktionsprodukte zusammengestellt.

¹¹) H. GILMAN, W. H. ATWELL, P. K. SEN u. G. L. SMITH, J. organometallic Chem. [Amsterdam] 5, 199 (1966).

¹²) F. G. WHITMORE, E. W. PIETRUSZA u. L. H. SOMMER, J. Amer. chem. Soc. 69, 2108 (1947).

¹³) B. N. Dolgow, S. N. Borisow u. M. G. Woronkow, J. gen. Chem. Moskow, 27, 716 (1957).

¹⁴) J. A. Kerr, B. A. Smith, A. F. Trotman-Dichenson u. J. G. Young, Chem. Commun. 1966, 157.

¹⁵⁾ G. Fritz u. R. Haase, unveröffentlicht; Dissertation R. Haase, Gießen 1967.

Tabelle 2 Verbindungen aus der Umsetzung von [20] mit [21]

		
$H_3Si-CH_2-SiH_2Cl$ [23]	Cl ₃ Si — CHCl — SiCl ₃	[4]
$\rm H_2ClSi-CH_2-SiClH_2$ [24]	$\text{Cl}_3\text{Si}-\text{CH}_2-\text{SiCl}_3$	[1]
$HCl_2Si-CH_2-SiH_3$ [25)		
$\mathrm{HCl_2Si-CH_2-SiClH_2}$ [26] ^a		
$HCl_2Si-CH_2-SiCl_2H$ [27]		

Ein vollständiger Austausch aller SiH-Gruppen ist nicht zu beobachten. 56% des eingesetzten H₃Si—CH₂—SiH₃ [21] wurden zu Verbindung [23] und 30% zu Verbindung [24] chloriert. Der Gesamtanteil der Verbindungen [25], [26], [27] beträgt etwa 14%.

Von der eingesetzten perchlorierten Verbindung [20] wurden 68% zum $(\text{Cl}_3\text{Si})_2\text{CHCl}$ [4] und 7.5% zu $(\text{Cl}_3\text{Si})_2\text{CH}_2$ [1] umgesetzt. Es konnten etwa 24% der unumgesetzten Ausgangsverbindung [20] wieder isoliert werden. Daraus ist zu ersehen, daß diese Austauschreaktion sowohl zur präparativen Darstellung der SiH-haltigen Verbindungen [23] und [24] als auch zur CH-teilchlorierten Verbindung [4] verwendet werden kann. Die Identifizierung der Verbindungen erfolgte über PMR-Spektrum Tab.6 und Molgewichtsbestimmung.

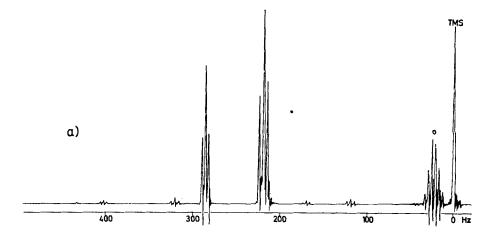
H₃Si—CH₂—SiH₂Cl [23]: Die Molgewichtsbestimmung (Dampfdichte) liefert die Werte 107,5 und 111, ber. 110,5. Sdp. 67°C (extrapoliert aus der Dampfdruckkurve).

Dampfdruckmessung:

Das PMR-Spektrum von [23] (Abb.3) enthält die voneinander getrennten SiH₃- und SiH₂Cl-Tripletts mit den Kopplungskonstanten von 4,5 bzw. 3,65 Hz bei 219,5 und 286 Hz. Die CH₂-Protonen zeigen das erwartete 12-Linienmultiplett aus einem Quartett (J=4,5 Hz) von Tripletts (J=3,65 Hz); Zentrum des Multipletts bei 23,5 Hz. Die Integration ergibt das für die Verbindung charakteristische Protonenverhältnis.

 H_2SiCl — CH_2 — SiH_2Cl [24]: Die Verbindung liegt bei der Abtrennung im Gemisch mit den Verbindungen [25] und [26] vor und bildet in dieser Fraktion den Hauptanteil. Molgewichtsbestimmung (Dampfdichte) gef. 145 und 149, ber. 145. Das PMR-Spektrum von [24] enthält ein Triplett (J=3.5~Hz) der SiH_2Cl -Protonen bei 288,5 Hz. Die beiden gleichwertigen SiH_2Cl -Gruppen spalten die CH_2 -Protonen in ein Quintett (J=3.5~Hz) auf; Zentrum bei 48 Hz.

 $\mathbf{HCl_2Si-CH_2-SiH_3}$ [25]: Die Verbindungen [25] und [26] wurden bei der Abtrennung sowohl im Gemisch mit [24] als auch mit [27] aufgefunden. Für [25] ist für die SiH₃-Protonen ein Triplett (J = 4,35 Hz) bei 220,5 Hz und für das SiHCl₂-Proton ein Triplett (J = 2,15 Hz) bei 335 Hz zu beobachten, die die mittelständige $\mathbf{CH_2}$ -Gruppe in ein Quartett von Dubletts aufspalten, dessen 8 Linien in den geforderten Intensitäten zu erkennen sind; Zentrum bei 40 Hz.



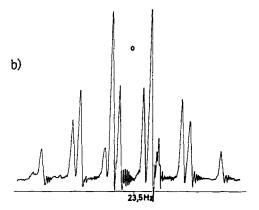


Abb. 3. PMR-Spektrum von H₃Si-CH₂-SiH₂Cl [23]. a) Übersichtsspektrum; b) CH₂-Bereich bei 50 Hz, in CCl₄: 60 MHz

 $HSiCl_2 - CH_2 - SiH_2Cl$ [26]: Im PMR-Spektrum erscheinen die beiden SiH-Gruppen als Triplett: SiHCl₂ (J = 2,1 Hz) bei 335 Hz und SiH₂Cl (J = 3,45 Hz) bei 291 Hz. Die CH_2 -Protonen werden durch diese in ein Dublett von Tripletts aufgespalten, Mittelpunkt bei 66 Hz.

HSiCl₂—CH₂—SiCl₂H [27]: Die Verbindung ist die sehwerflüchtigste in dieser Gruppe. Im PMR-Spektrum liegt die SiHCl₂-Gruppe (Triplett J \sim 2,3 Hz) bei 338 Hz und spaltet die CH₂-Protonen in ein Triplett auf, das in dieser Verbindungsreihe auf tiefstem Feld liegt (82 Hz).

Nachdem die Verbindungen [23] bis [27] durch Abkondensieren aus dem Reaktionsgemisch entfernt waren, zeigte der Rückstand noch 2 Resonanzlinien bei 108 und 198 Hz, die den Verbindungen [1] und [4] zuzuordnen sind. Um die Anteile dieser Verbindungen neben dem im PMR-Spektrum nicht sichtbaren (Cl₃Si)₂CCl₂ [20] zu bestimmen, wurde der Rückstand mit LiAlH₄ umgesetzt, wobei erwartungsgemäß (H₃Si)₂CH₂ [21], (H₃Si)₂CHCl

[14] und (H₃Si)₂CCl₂[22] gebildet werden, unter denen Verbindung [4] Hauptprodukt ist. Die drei SiH-haltigen Carbosilane wurden über ihre PMR-Spektren charakterisiert und bestätigen die Bildung von [1] und [4] bei der Umsetzung.

2. Umsetzung von $(Cl_3Si-CCl_2)_2SiCl_2$ [9] mit $(H_3Si-CH_2)_2SiH_2$ [28]

Die Austauschreaktionen führen auch bei der Umsetzung der Verbindung [9] mit [28] zur Bildung teilchlorierter Verbindungen. Bei einem Molverhältnis der Verbindung [9]:[28] = 1:1 werden innerhalb 10 Tagen bei 95°C die in Tab. 3 angegebenen Verbindungen gebildet. Dabei ist kein Abbau der Kette zu beobachten. Die Austauschreaktion entspr. Gl. (2) verläuft mit einer Ausbeute von 80%.

Tabelle 3 $\label{eq:constraint} \text{Umsetzungsprodukte } (\text{Cl}_3\text{Si}-\text{CCl}_2)_2\text{SiCl}_2 \ [9] \ \text{mit } \ (\text{H}_3\text{Si}-\text{CH}_2)_2\text{SiH}_2 \ [28]$

$\mathbf{H_2ClSi-CH_2-SiH_2-CH_2-SiH_3}$	[29]	$\text{Cl}_3\text{Si}-\text{CHCl}-\text{SiCl}_2-\text{CCl}_2-\text{SiCl}_3$	[7]
$\mathbf{H_3Si-CH_2-SiHCl-CH_2-SiH_3}$	[30]	${\rm Cl_3Si-CHCl-SiCl_2-CHCl-SiCl_3}$	[8]
$\mathbf{H_3Si}\!-\!\mathbf{CH_2}\!-\!\mathbf{SiHCl}\!-\!\mathbf{CH_2}\!-\!\mathbf{SiH_2Cl}$	[31]	$\text{Cl}_3\text{Si}\!-\!\text{CH}_2\!-\!\text{SiCl}_2\!-\!\text{CCl}_2\!-\!\text{SiCl}_3$	[6]
$\mathbf{H_2ClSi-CH_2-SiH_2-CH_2-SiH_2Cl}$	[32]	$Cl_3Si-CHCl-SiCl_2-CH_2-SiCl_3$	[5]

63% des eingesetzten (H₃Si-CH₂)₂SiH₂ [28] wurden chloriert. Unter den Chlorierungsprodukten bestehen 70% aus den monochlorierten Verbindungen [29] und [30], die im Verhältnis 3:2 vorliegen und das Hauptprodukt der SiH-haltigen Anteile bilden. Die restlichen 30% der SiH-haltigen Umsetzungsprodukte bestehen aus den Verbindungen [31] und [32], wobei die unsymmetrische Verbindung [31] Hauptanteil ist. Die mit der Chlorierung der SiH-Bindung verbundene Hydrierung der CCl-Bindung führt bevorzugt zu Verbindung [7] und nur in geringen Mengen zu [8], [6] und [5]. Eine vollständige Überführung aller CCl₂ in CH₂-Gruppen [zu Verbindung (Cl₃Si-CH₂)₂SiCl₂ [2]] wird nicht beobachtet. Diese SiCl-haltigen Verbindungen [5] bis [8] wurden durch die Umsetzung mit LiAlH₄ in die Verbindungen [33], [34], [16], [15] überführt, die auf Grund ihrer charakteristischen Gruppierungen über das PMR-Spektrum und die massenspektrometrische Untersuchung identifiziert werden konnten.

$$H_{3}Si-CHCl-SiH_{2}-CCl_{2}-SiH_{3}$$
 [33]
 $H_{3}Si-CHCl-SiH_{2}-CHCl-SiH_{3}$ [34]
 $H_{3}Si-CH_{2}-SiH_{2}-CCl_{2}-SiH_{3}$ [16]
 $H_{3}Si-CHCl-SiH_{2}-CH_{2}-SiH_{3}$ [15]

Die Aufarbeitung der Reaktionsprodukte aus der Umsetzung von [9] mit [28] erfolgte durch fraktionierte Kondensation. Die noch flüchtigen Carbosilane [28] bis [32] gehen im

Ölpumpenvakuum bei 70°C in eine mit fl. N₂ gekühlte Vorlage. [5] bis [9] und der Restanteil von [31] und [32] bleiben im Rückstand. Aus dem abkondensierten Verbindungsgemisch läßt sich [28] (nicht umgesetzte Ausgangsverbindung) abtrennen. Eine vollständige Auftrennung der SiH-chlorierten Carbosilane [29] bis [32] gelingt nicht. Es lassen sich aber zwei Fraktionen gewinnen, die hauptsächlich [29] und [30] (Fraktion 1) und [31] und [32] (Fraktion 2) enthalten. Die Identifizierung der in den Gemischen vorliegenden Verbindungen erfolgte zunächst über das PMR-Spektrum. Die PMR-Spektren beider Fraktionen unterscheiden sich deutlich von der perhydrierten Verbindung [28]. Deutlich ist die Verschiebung der SiCH-Multipletts zu niederem Feld und die Bildung neuer Multipletts im SiHCl-Bereich. Ausgangspunkt für die Zuordnung der Resonanzlinien werden damit die Multipletts im SiH-Bereich.

Gruppe der Verbindungen [29] und [30] (Fraktion 1): Aus der relativen Flüchtigkeit und aus dem Intensitätsverhältnis (PMR-Spektrum) der SiHCl- und SiH $_2$ -Protonen ist anzunehmen, daß in dieser Fraktion die monochlorierten Verbindungen vorliegen.

Die Multipletts im SiHCl-Bereich bestehen aus einem intensitätsstarken Triplett bei 286 Hz und einem schwächeren Quintett bei 294 Hz, aus denen auf eine SiH₂Cl und eine mittelständige SiHCl-Gruppierung zu schließen ist. Der SiH-Bereich zeigt die zu Verbindung [29] und [30] gehörenden Multipletts; zwei Tripletts und ein Quintett. Das nur wenig intensitätsstärkere bei etwas tieferem Feld liegende Triplett ist Verbindung [30] zuzuordnen, da deren SiH₃-Gruppen gleichwertig sind und stärker durch die SiHCl-Gruppe beeinflußt werden als die weiter entfernt liegende SiH₃-Gruppe in Verbindung [29]. Da die Intensität der 6 SiH-Protonen in [30] nur wenig größer ist als die der 3 Protonen der SiH₃-Gruppe in Verbindung [29], folgt daraus das Verhältnis der Verbindungen [29] und [30] im Verbindungsgemisch; Verhältnis 1,5:1. Aus den Kopplungskonstanten der Multipletts im SiHClund SiH-Bereich ergeben sich die geforderten Aufspaltungen für die zwei verschiedenen CH₂-Gruppen in [29] und [30]: Für [29]

- a) ClSiH₂-CH₂-SiH₂- als Triplett von Tripletts und
- b) $-SiH_2-CH_2-SiH_3$ als Triplett von Quartetts;

für die beiden gleichwertigen CH₂-Gruppen in Verbindung [30]:

Alle anderen Kombinationen, wie z.B. ClSiH₂—CH₂—SiHCl- oder ClH₂Si—CH₂—SiCl₂—sind nicht mit den beobachteten Multipletts in Einklang zu bringen. PMR-Spektrum von [29] und [30] Tab.6. Die massenspektrometrische Untersuchung bestätigt die Summenformel Si₃C₂H₁₁Cl. In Tab.5 sind die Werte der exakten Massenbestimmung zusammengestellt.

Gruppe der Verbindungen [31] und [32]

In Fraktion 2 waren die dichlorierten Verbindungen zu erwarten. Da im PMR-Spektrum des Gemisches die Multipletts im $SiHCl_2$ -Bereich fehlen, sind nur Verbindungen mit monochlorierten Si-Atomen vorhanden. Die auftretenden Resonanzlinien lassen sich den Verbindungen [31], [32] zuordnen. Verbindung [31] ist der Hauptanteil. Die PMR-Spektren von [31] und [32] sind in Tab. 6 wiedergegeben. Die massenspektrometrische Bestimmung ergibt die Summenformel $Si_3C_2H_{10}Cl_2$; exakte Massenbestimmung Tab. 5.

Der Reaktionsrückstand zeigt nach Abtrennen der SiHCl-Verbindungen im PMR-Spektrum neben geringen Anteilen der Verbindungen [31] und [32] hauptsächlich Resonanzlinien im CHCl- und in geringerer Intensität im CH₂-Bereich. Die Linie bei 219 Hz ist im Vergleich zu allen anderen sehr intensitätsstark. Ähnlich wie bei der Umsetzung von $(Cl_3Si)_2CCl_2$ können hier die am C-Atom halogenierten Verbindungen [5] bis [8] erwartet werden, wobei lediglich die nicht umgesetzte Ausgangsverbindung [9] im Spektrum nicht auftreten kann. Da die Verbindungen [6], [5] und [2] dieser Reihe bekannt sind, lassen sich ihre Resonanzlinien mit denen des Reaktionsrückstandes vergleichen. Danach sind [6] und [5] nur in geringem Anteil im Substanzgemisch und [2] fehlt vollkommen. Für die Verbindungen [7] und [8] ist je eine Resonanzlinie zu erwarten, wobei die von [7] bei niederem Feld liegt. Ihr ist die Linie bei 219 Hz zuzuordnen, wie durch die anschließenden Umsetzungen des Reaktionsrückstandes mit LiAlH₄ bestätigt wird.

Im Spektrum werden noch 5 Linien im CHCl-Bereich beobachtet. Ähnliche Erscheinungen treten bei der Reaktion von $(Cl_3Si-CCl_2)_2SiCl_2$ mit $(H_3Si)_2CH_2$ auf. Diese überzähligen Resonanzlinien sind darauf zurückzuführen, daß Verbindung [9] noch einen geringen Anteil von $(Cl_2Si-Cl_2)_3$ enthält. Da die Ringverbindungen $(Cl_2Si-CCl_2)_3$ leicht zu enthalogenieren ist, sind diese CHCl-Absorptionen diesen Derivaten zuzuordnen. Bei der Umsetzung mit LiAlH₄ können die linearen Anteile von diesen schwerer kondensierbaren Verbindungen abgetrennt werden.

Zur weiteren Identifizierung dieses Substanzgemisches, wurde die Umsetzung mit LiAlH₄ durchgeführt, um die SiCl-Gruppen in SiH-Gruppen zu überführen und damit aussagefähige PMR-Spektren zu erhalten. Nach den vorausgehenden Untersuchungen¹⁰) waren in der Reihe der SiH-haltigen, C-teilchlorierten Verbindungen lediglich noch die Verbindungen [33] und [34] unbekannt, was die Identifizierung erheblich erleichtert. Die Umsetzung des Substanzgemisches mit LiAlH₄ wurde in Ablehnung an die Erfahrungen bei der Bildung von (H₃Si-CCl₂)₂SiH₂ vorgenommen¹⁰). Auffallend ist, daß sich das Reaktionsgemisch ziegelrot färbt. Die Reduktion führt zu den bereits bekannten Verbindungen (H₃Si-CCl₂)₂SiH₂ [35], [16], [15] und (H₃Si-CH₂)₂SiH₂ (aus [31] und [32]) neben geringen Mengen SiH₄ und (H₃Si)₂CCl₂ [22] (durch Spaltung von [35]⁹)). Hauptprodukt im Verbindungsgemisch ist H₃Si-CHCl-SiH₂-CCl₂-SiH₃ [33]. Als weitere Verbindung wurde H₃Si-CHCl-SiH₂-CHCl-SiH₃ [34] identifiziert, deren Flüchtigkeit der von Verbindung [16] gleichkommt.

PMR-Spektrum von [33]

$${\rm H_3Si-CCl_2-SiH_2-CHCl-SiH_3}^{(2)}.$$

Für die SiH₃-Gruppe (1) wird bei höchster Auflösung infolge Fernkopplung mit Proton (2) ein Triplett ($J_{SiH_3CCl_2-SiH_2} = 0.4 \pm 0.1$ Hz) beobachtet, das bei 255,5 Hz zwischen den entsprechenden SiH₃-Gruppen der Verbindung [35] und [16] (Tab. 6) liegt und das auch für eine $H_3Si-CCl_2-SiH_2$ -Anordnung zu erwarten ist.

Die SiH₂-Gruppe (2) zeigt das durch (3) verursachte Dublett (J=3,55 Hz), das durch (1) weiter aufgespalten wird. Die doppelte Quartettstruktur wird nicht mehr aufgelöst, zumal weiterhin mit Fernkopplungen von (4) zu rechnen ist. Es treten zwei breite Absorptionsbanden auf; Zentrum 266,5 Hz.

Für das CHCl-Proton (3) wird ein 6-Linienmultiplett bei 182 Hz beobachtet. Das Aufspaltungsschema, das sich aus den Kopplungskonstanten von (2) und (4) ergibt, stimmt mit der Struktur des gefundenen Multipletts überein.

Die SiH_3 -Gruppe (4) zeigt wie (2) ein Dublett, das bei höherem Feld als das von (2) zu erwarten ist. Es erscheint bei 241 Hz, Halbwertsbreite beider Linien 0,65 Hz. Die Kopplungskonstante beträgt 3,7 Hz.

PMR-Spektrum von Verbindung [34]:

$$_{3}^{(1)}$$
 $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3}^{(1)}$ $_{3}^{(2)}$ $_{3$

Die beiden gleichwertigen SiH₃-Gruppen (1) werden durch das Proton (2) in ein Dublett ($J=3,7~\mathrm{Hz}$) aufgespalten; Mittelpunkt bei 237,5 Hz; Halbwertsbreite der Linien 0,6 Hz. Die CHCl-Resonanzen der Protonen (2) zeigen das zu erwartende Multiplett bei 180 Hz und unterscheiden sich von den ähnlichen CHCl-Multipletts der Verbindungen [33] und [15] in ihrer Lage. Die Protonen (3) der SiH₂-Gruppe werden durch die benachbarten CHCl-Gruppen in ein Triplett aufgespalten; wahrscheinlichste Werte: Kopplungskonstante $J=3,5~\mathrm{Hz}$, bei 252 Hz. Die Verbindungen [16] und [34] (Isomere) haben etwa gleiche Flüchtigkeit und sind deshalb schwer zu trennen. Die genaue Zuordnung der SiH₂-Resonanzen wird dadurch erschwert, daß die SiH₂-Multipletts von [34] mit denen von [16] praktisch zusammenfallen. Aus der Integration des PMR-Spektrums des reduzierten Verbindungsgemisches nach Abtrenneng von Verbindung [28] und geringer Anteile von [15] ergeben sich für die folgenden Anteile (Mol-%):

[35]	$\mathbf{H_3}\mathrm{Si}\mathrm{-CCl_2}\mathrm{-SiH_2}\mathrm{-CCl_2}\mathrm{-SiH_3}$	26%
[33]	$\mathbf{H}_3\mathrm{Si-CHCl-SiH}_2\mathrm{-CCl}_2\mathrm{-SiH}_3$	52%
[34]	$\mathbf{H_3Si-CHCl-SiH_3-CHCl-SiH_3}$	10%
[16]	$\mathbf{H_3Si-CH_2-SiH_2-CCl_2-SiH_3}$	12%

Verbindung [15] wurde nicht bestimmt, da ihr Anteil sehr gering ist. Für die Bestimmung des prozentualen Anteils wurden die in den Verbindungen gekennzeichneten Multipletts herangezogen.

3. Umsetzung von $(Cl_3SiCCl_2)_2SiCl_2$ [9] mit $(H_3Si)_2CH_2$ [28]

Bei der Umsetzung der Verbindung [9] mit [28] wird auf Seite der C-chlorierten Verbindungen als Hauptprodukt Cl₃Si-CHCl-SiCl₂-CCl₂-SiCl₃ [7] erhalten. Die Umsetzungen von (Cl₃Si-CCl₂)₂SiCl₂ mit (H₃Si)₂CH₂ im Molverhältnis 1:1,1 (Benzol als Lösungsmittel) wurde vorgenommen, um den Lösungsmitteleinfluß festzustellen und um zu überprüfen, ob bei schrittweiser Zugabe der perhydrierten Verbindung (H₃Si)₂CH₂ der Anteil an Cteilchlorierten Derivaten von [9] größer wird. Die Untersuchung zeigt, daß an SiH-chlorierten Verbindungen fast ausschließlich H₂ClSi-CH₂-SiH₃ gebildet wird und daß selbst bei einem Überschuß der perhydrierten Verbindung im Verhältnis 1:2 [7] Hauptprodukt dieser Verbindungsklasse bleibt neben nur geringen Mengen von [6] und [8], die im gleichen Verhältnis auftreten. Die Identifizierung von [7], [6] und [8] erfolgt auch hier über die SiH-haltigen Verbindungen [33], [34] und [16]. Demnach ist eine weitere Enthalogenierung von Verbindung [7] in zwei Richtungen möglich, wie es in der Bildung der Verbindungen [6] und [8] zum Ausdruck kommt. Aus der Umsetzung von (H₃Si)₂CH₂ [21] zum H₂ClSi-CH₂-SiH₃ [23] ergibt sich, daß mehr als 58% von Ausgangsverbindung [9] am C-Atom hydriert wurden. Die Hauptreaktion des Wasserstoff-Chlor-Austausch wird durch Gl. (3) beschrieben.

$$\begin{split} &(\operatorname{Cl}_3\operatorname{Si}-\operatorname{CCl}_2)_2\operatorname{SiCl}_2 + (\operatorname{H}_3\operatorname{Si})_2\operatorname{CH}_2 \to \operatorname{Cl}_3\operatorname{Si}-\operatorname{CHCl}-\operatorname{SiCl}_2-\operatorname{CCl}_2-\operatorname{SiCl}_3 \\ &\quad + \operatorname{H}_2\operatorname{ClSi}-\operatorname{CH}_2-\operatorname{SiH}_3. \end{split}$$

4. Umsetzung des cyclischen (Cl₂Si-CCl₂)₃ [12] mit (H₃Si-CH₂)₂SiH₂ [28]

Ähnlich wie die linearen Verbindungen zeigt auch die cyclische Verbindung [12] die Austauschreaktion. Orientierende Umsetzungen zwischen [12] und (H₃Si)₂CH₂ [21] geben zu erkennen, daß auch hier an SiCl-haltigen Produkten bevorzugt H₂ClSi—CH₂—SiH₃ [23] gebildet wird und daß in der cyclischen Verbindung CHCl-Gruppen entstehen, wie aus den im PMR-Spektrum auftretenden Resonanzlinien bei 204 und 219 Hz zu ersehen ist und was durch die Umsetzung der cyclischen Verbindungen mit LiAlH₄ gesichert wird. Bei diesen Umsetzungen scheint es aus experimentellen Gründen zweckmäßig, das flüchtige (H₃Si)₂CH₂ (Kp. 17°C) durch das schwerer flüchtige (H₃Si—CH₂)₂SiH₂ [28] zu ersetzen. Die Umsetzung der beiden Verbindungen im Molverhältnis 1:3,1 führt zu einem Umsatz von über 90% nach Gl. (4).

$$(\operatorname{Cl_2Si-CCl_2})_3 + 3 (\operatorname{H_3Si-CH_2})_2 \operatorname{SiH_2} \rightarrow (\operatorname{Cl_2Si-CH_2})_3 +$$

$$3 \operatorname{H_2ClSi-CH_2-SiHCl-CH_2-SiH_3}$$

$$[31]$$

Verbindung [31] ist Hauptprodukt der SiHCl-haltigen Verbindungen neben [32] und geringen Mengen an [19] und [30]. Die entsprechende Hydrierung der CCl₂-Gruppen in [12] führt zum (Cl₂Si-CH₂)₃ [3], das auch über die Umsetzung zum (H₂Si-CH₂)₃ [36] gesichert wurde. Es ist demnach auch die vollständige Hydrierung der CCl₂-Gruppen auf diesem Wege möglich. Die Austauschreaktionen zwischen (Cl₂Si-CCl₂)₃ [12] mit (H₃Si- $(CH_2)_2SiH_2$ [28] im Molverhältnis 1:1,5 führt zu einer nahezu vollständigen Umsetzung der perhydrierten Kette [28], wobei in dieser 3—5 SiCl-Gruppen eingeführt werden. Nach dem PMR-Spektrum liegen folgende Gruppierungen vor: -SiHCl₂ ~340 Hz (Tripletts), J ~2,2 Hz; -SiHCl ~306 Hz (Quintetts); -SiH₂Cl ~292 Hz (Tripletts); -CH₂-67-51 Hz. Daraus ist zuschließen, daß die Verbindungen HCl₂Si-CH₂-SiHCl-CH₂-SiH₂Cl[37] und (HCl₂Si-CH₂)₂SiHCl [8] vorliegen. Hauptprodukt der SiHCl-haltigen Derivate ist Verbindung [37]. Der Anteil an mono- und dichlorierten Verbindungen ist gegenüber Verbindung [37] zu vernachlässigen. Die gleichzeitig damit erfolgende Hydrierung des (Cl₂Si-CCl₂)₃ führt zum CHCl-haltigen Ring [11], zur CH₂ enthaltenen Verbindung (Cl₃Si-CH₂)₃ [3] und in geringem Umfang zu Verbindung [10] mit einer CCl₂-Gruppe.

Der Austausch zwischen SiH- und $\mathrm{CCl_2}$ -Gruppen wird auch zwischen $(\mathrm{Cl_2Si-CCl_2})_3$ und $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{SiH}$ beobachtet. Dabei werden neben $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{SiCl}$ Derivate des $(\mathrm{Cl_2Si-CCl_2})_3$ mit CHCl-Gruppen beobachtet, die sich jedoch nicht als reine Produkte abtrennen lassen, für die aber nach der Umsetzung mit LiAlH $_4$ sichere Anhaltspunkte aus dem PMR-Spektrum erhalten werden.

5. Umsetzung von $(Cl_2Si-CCl_2)_3$ [12] mit $(H_2Si-CH_2)_3$ [36], Molverhältnis 1:1,1

Spezielles Interesse besteht für die Bildungsreaktionen teilehlorierter cyclischer Carbosilane. Aus diesem Grunde wurde die Umsetzung der Verbindungen [12] und [36] untersucht, wobei Benzol als Lösungsmittel für das kristalline [12] und die entstehenden SiHCl- und CHCl-haltigen cyclischen Verbindungen gewählt wurde. Die bei der Umsetzung zu erwartenden Verbindungen sind in Tab. 4 zusammengestellt.

Tabelle 4
Reaktionsprodukte aus (Cl₂Si-CCl₂)₃ und (H₂Si-CH₂)₃

$$[38](6) \ H_2C \ Si \ CH_2 \ (2) \ (5) \ H_2Si \ CH_2 \ (3) \ SiH_2 \ (3) \ Cl_2Si \ Cl_2 \ SiCl_2 \ (4) \ Si \ CH_2 \ (2) \ (5) \ H_2 \ Si \ CH_2 \ (2) \ (5) \ CH_2 \ Si \ CH_2 \ (2) \ (5) \ CH_2 \ Si \ CH_2 \ (2) \ CH_2 \ CH_2 \ (3) \ CH_2 \ CH_2 \ (4) \ CH_2 \ CH$$

Bei der Umsetzung werden 95% des hydrierten Ringes [36] chloriert, davon 63% zu Verbindung [38] und 37% zu [39]. Die Bildung der Verbindungen [38] und [39] folgt aus den PMR-Spektren, der massenspektrometrischen Untersuchung und der Überführung beider Verbindungen in $(H_2Si-CH_2)_3$ [36].

Das Spektrum des Verbindungsgemisches (Abb. 4) zeigte Multipletts im SiH und SiCH-Bereich. Aus der chemischen Verschiebung der zwei getrennten Absorptionen im SiH-Bereich ist zu entnehmen, daß SiHCl- und SiH₂-Gruppen vorliegen. Ein Ansatz für die Aufklärung des Substanzgemisches ergibt sich aus der Dreiteilung der insgesamt zu niederem Feld verschobenen CH₂-Absorptionen (a, b, c). Es liegen drei verschiedene Protonenarten vor.

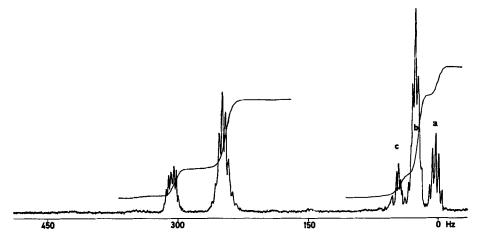


Abb. 4. PMR-Spektrum des Gemisches der Verbindungen [38] und [39], in CCl₄: 60 MHz

Nachdem durch eine weitergehende Auftrennung des Verbindungsgemisches sichergestellt war, daß jeweils zwei der drei Multipletts zu einer Verbindung gehören, kommen nur die Strukturformeln von [38] und [39] in Betracht.

Das Multiplett bei höchstem Feld (a) kann nur der CH₂-Gruppe (4) von [38] und das bei niedrigstem Feld gelegene Multiplett (c) der CH₂-Gruppe (4) der Verbindung [39] zugeordnet sein. Anhand dieser Multipletts ist auch eine Bestimmung der Anteile von [38] und [39] im Gemisch durch Integration möglich. Das zwischen beiden liegende intensitätsstarke Multiplett (b) wird durch die jeweils gleichen CH₂-Gruppen (2) und (6) von [38] und (2) und (6) von [39] verursacht.

Die Substanzproben für die PMR- und Massenspektren wurden den am leichtesten bzw. am schwersten flüchtigen Anteilen des Gemisches entnommen; PMR-Sepktrum von [38], [39] Tab.6. Die Formel Si₃C₃H₉Cl₂ (M—H) für [39] folgt aus der massenspektrometrischen Untersuchung; exakte Massenbestimmung Tab.5.

Die Verbindungen [40], [41] und [42] waren nicht näher zu charakterisieren. Auf ihre Bildung ist aus dem Reaktionsablauf, der Isolierung der Verbindungen [38] und [39] und aus dem Auftreten der CHCl-Resonanzen im Gemisch des Reaktionsrückstandes nach Abtrennung von [38] und [39] zu schließen. Auch nach Umsetzung mit LiAlH₄ war keine weitere Auftrennung möglich.

Die Umsetzung von $(Cl_2Si-CCl_2)_3$ [12] mit $(H_2Si-CH_2)_3$ [36] im Verhältnis 1:1,5 führt zur vollständigen Hydrierung der CCl₂-Gruppen. Aus [12] bildet sich $(Cl_2Si-CH_2)_3$ [3]. CHCl-haltige Verbindungen werden nicht beobachtet. Entsprechend werden in [36] 3-5 SiCl-Gruppen eingeführt, wie aus dem PMR-Spektrum zu entnehmen ist $(SiCH_2-Multipletts bei 52$

Tabelle 5 Massenbestimmung

Nr.	Verbindung	exakte Massen- bestimmung	gemessen	berechnet	Differenz in ppm
[29]	H ₂ ClSi-CH ₂ -SiH ₂ -CH ₂ -SiH ₃	$\mathbf{M} - \mathbf{H}$ $\mathrm{Si}_3\mathrm{C}_2\mathbf{H}_{10}^{38}\mathrm{Cl}$	152,97807	152,97738	4,5
[31]	$\mathbf{H_3Si-CH_2-SiHCl-CH_2-SiH_2Cl}$	$\mathbf{M} - \mathbf{H}$ $\mathrm{Si}_{\mathbf{a}}\mathrm{C}_{2}\mathbf{H}_{\mathbf{a}}\mathrm{Cl}_{2}$	186,93842	186,93791	2,7
[16]	H ₃ Si-CCl ₂ -SiH ₂ -CH ₃ -SiH ₃	$Si_3C_2H_{10}^{35}Cl^{37}Cl$ $Si_3C_2H_{10}Cl_2$	189,94316 187,94620	189,94328 187,94573	0,6 2,5
[39]	HCI H2C Si CH2 H2Si SiH2	$\begin{array}{l} \mathbf{M-H} \\ \mathrm{Si_{3}C_{3}H_{10}}^{27}\mathrm{Cl} \\ \mathrm{^{28}Si_{2}}^{29}\mathrm{SiC_{3}H_{10}}^{35}\mathrm{Cl} \\ \mathrm{Si_{3}C_{3}H_{10}}^{35}\mathrm{Cl} \end{array}$	166,97510 165,97773 164,97729	166,97492 165,97694 164,97738	1,1 4,7 0,5
[40]	HCI H ₂ C Si CH ₂ H ₃ Si CH ₃ H ₄ Si C H ₄ Si	$egin{align*} \mathbf{M} - \mathbf{H} \\ ^{28} \mathrm{Si}_2 ^{29} \mathrm{SiC}_3 \mathbf{H_9} ^{55} \mathrm{Cl}_2 \\ \mathrm{Si}_3 \mathrm{C}_8 \mathbf{H_9} ^{55} \mathrm{Cl}_2 \\ \end{aligned}$	199,93847 198,93951	199,93747 198,93791	5,0 8,0
[18]	H ₂ H ₂ Si CH ₂ H ₂ Si CH ₂ H ₂ Si H ₂ SiH ₃	M - H Si ₃ C ₃ H ₁₀ ³⁷ Cl Si ₃ C ₃ H ₁₀ ³⁵ Cl	166,97360 164,97744	166,97492 164,97738	7,9 0,4
[17]	H ₂ Si CH ₂ SiH ₂ CCl ₂	$Si_3C_4H_{10}^{35}Cl^{37}Cl$ $Si_3C_3H_{10}^{35}Cl_2$	201,94413 199,94693	201,94328 199,94573	4,2 6,0

Gemessen mit SM1 Massenspektrometer Varian MAT GmbH; 8 kV; 70 eV, Elektronenstrom 300 µA.

und 67,5 Hz und SiHCl-Multipletts bei 314 Hz; SiH: CH-Verhältnis 1:3,8). Der Reaktionsablauf wird durch Gl. (5) wiedergegeben.

$$\begin{array}{c} (\operatorname{Cl_2Si-CCl_2})_3 \to (\operatorname{Cl_2Si-CH_2})_3 \\ (\operatorname{H_2Si-CH_2})_3 \to (\operatorname{Cl_xH_ySi-CH_2})_3. \end{array}$$

IV. Umlagerung von H₃Si -CHCl -SiH₃ [14]

[14] lagert sich bei Raumtemperatur innerhalb von zwei Jahren um, wie den Veränderungen im PMR-Spektrum zu entnehmen ist. Es bilden sich $(H_3Si)_2CH_2$ [21], $H_3Si-CH_2-SiH_2Cl$ [23], $H_3Si-CHCl-SiH_2Cl$ [43] $H_2ClSi-CH_2-SiH_2Cl$ [24] und $H_3Si-CH_2-SiHCl_2$ [25]. Wird die Substanzprobe 10 Tage auf 60 °C erwärmt, so nimmt die Menge der Umlagerungsprodukte zu. $H_3Si-CHCl-SiH_2Cl$ [44] und $H_3Si-CH_2-SiH_2Cl$ entstehen etwa im gleichen Verhältnis.

Tabelle 6 PMR-Spektren der Carbosilane

Nr. der Ver- bindung	Verbindung	$ au ext{-Wertea}$)(± 0.02); Kopplungskonstanten $ ext{J}_{ ext{SiH}- ext{CH}} \pm 0.2 ext{Hz}$; $ ext{J}_{ ext{soSiH}} \pm 1 ext{ Hz}$
[1]	Cl _s Si-CH ₂ -SiCl ₃	τ ₁ : 8,17(1)
[2]	$Cl_2Si-CH_2-SiCl_2-CH_2-SiCl_3$	$\tau_1 = \tau_2$: 8,32(1)
[3]	$(Cl_1Si - CH_2)_3$	$\tau_1 = 8,55(1)$
[4]	$Cl_8Si - CHCl - SiCl_8$	$ au_1 = 6,70(1)$
[5]	$\text{Cl}_{\mathbf{s}}\text{Si} - \text{CH}^{1}\text{Cl} - \text{SiCl}_{\mathbf{s}} - \text{CH}^{2} - \text{SiCl}_{\mathbf{s}}$	τ ₁ : 6,70(1); τ ₂ : 8,21; 8,25
[6]	$\text{Cl}_{\textbf{3}}\text{Si} - \text{CCl}_{\textbf{3}} - \text{SiCl}_{\textbf{3}} - \text{CH}_{\textbf{2}} - \text{SiCl}_{\textbf{3}}$	r ₁ : 8,15(1)
[7]	$Cl_3Si - CHCl - SiCl_2 - CCl_2 - SiCl_3$	τ ₁ : 6,32(1)
[10]	Cl _z Si CH _z Cl _z Cl _z Cl _z Cl _z SiCl _z	$\tau_1 = \tau_2$: 8,40(1)
[11]	Cl ₁ Si CH ₂ Cl ₂ Si CH ₂ Cl ₃ Cl ₄ SiCl ₂ HCl	$\tau_1 = \tau_2$: 8,47(1); τ_8 : 6,79(1)
[13]	Cl _z Si CCl _z Cl _z SiCl _z SiCl _z	τ ₁ : 8,25(1)
[15]	$^{1}_{H_{3}Si} - ^{2}_{CHCl} - ^{3}_{Si} + ^{4}_{2} - ^{5}_{CH_{2}} - ^{5}_{Si} + ^{5}_{Si}$	$ au_1$: 6,11(2); $ au_2$: 7,22(6); $ au_3$: 5,94(4); $ au_4$: 9,93(6); $ au_5$: 6,32(3); $ au_{1-2} = 3,75 ext{ Hz}$; $ au_{3-2} = 3,5 ext{ Hz}$; $ au_{3-4} = 4,3 ext{ Hz}$; $ au_{5-4}$: 4,5 Hz
[17]	H ₂ C CH, H ₃ Si CH, CCl ₂	$ au_1$: 5,90(5); J = 3,5 Hz; $ au_2 = au_6$: 9,74(5), J = 3,4: Hz; $ au_3 = au_4$: 5,67(3); J = 3,0 Hzb); J ₃₀ S1H ₂ (3-4) = 215 Hz
[18]	H ₂ Si CH ₂ Si SiH ₃ H ₄ C HCI	$ au_1= au_3= au_5$: 5,78 (nicht aufgelöstes Multiplett); $ au_2= au_6$: 9,93(5); J = 3,6 Hz; $ au_4$: 7,15 (nicht aufgelöst)
[19]	$\begin{array}{c} H_{a} \\ \text{Si} \\ \text{Cl}_{2}C \\ \downarrow \\ H_{2}\text{Si} \\ \downarrow \\ \text{Si} \\ H_{2} \end{array}$	$\tau_1: 5,40(1) \text{ (JS1H}_2-\text{CCl}_2-\text{S1H}_2=0.9 \text{ Hz)}; \ \tau_2=\tau_4\colon 5,60(3),$ $J=3,3 \text{ Hz}; \ \tau_3: 9,50(5), \ J=3,3 \text{ Hz}b)$

Tabelle 6 (Fortsetzung)

Nr. der Ver- bindung	Verbindung	τ-Wert2) (\pm 0,02); Kopplungskonstanten J $_{S1H}$ -CH \pm 0,2Hz; J $_{29}$ S1H \pm 1 Hz
[23]	$H_{\bullet}Si - CH_{\bullet} - SiH_{\bullet}CI$	$ au_1$: 6,34(3); $ au_2$: 9,61(12); $ au_3$: 5,23; $ extbf{J}_{1-2} = extbf{4}$,5 Hz; $ extbf{J}_{3-2} = extbf{3}$,65 Hz; $ extbf{J}_{2}$ sSiH ₃ = 202 Hz; $ extbf{J}_{2}$ sSiH ₂ Cl = 233 Hz
[24]	$Cl\mathbf{H}_{2}\mathbf{Si} - C\mathbf{H}_{2} - \mathbf{SiH}_{2}Cl$	$ au_1 = au_2$: 5,19(3); $ au_2$: 9,20(5); $ ext{J}_{SiHCl-CH} = 3.5 \text{ Hz}$; $ ext{J}_{10}\text{SiH}_{9}\text{CI} = 237 \text{ Hz}$
[25]	$^{1}_{\mathbf{H_{3}Si-CH_{2}-SiHCl_{2}}}$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
[26]	ClH ₃ Si-CH ₃ -SiHCl ₃	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
[27]	$\mathbf{Cl_2HSi-CH_2-SiHCl_2}^{1}$	$ au_1 = au_3$: 4,37(3) $ au_2$: 8,63(3); $ ext{J}_{\mathrm{S1HCl}_2 - \mathrm{CH}_2} \sim 2.3 \; \mathrm{Hz}$
[29]	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
[30]	$\mathbf{H}_{9}^{1}\mathbf{Si} - \mathbf{CH}_{9} - \mathbf{SiHCl} - \mathbf{CH}_{9} - \mathbf{SiH}_{3}^{\bar{5}}$	$ au_1 = au_5$; 6,38(3); $ au_2 = au_4$; 9,66(8); $ au_3$; 5,10(5); $ ext{J}_{\text{S1H}_2-\text{CH}_2} = 4,5 \text{ Hz}$ $ ext{J}_{\text{S1HCl-CH}_2} = 3,15 \text{ Hz}$
[31]	$\text{Cl}\mathbf{H}_{2}\text{Si} - \text{C}\mathbf{H}_{2} - \text{Si}\mathbf{H}\text{Cl} - \text{C}\mathbf{H}_{2} - \text{Si}\mathbf{H}_{3}$	$\begin{array}{c} \mathbf{r}_1; \; \mathbf{5,15(3)}; \; \mathbf{r}_2; \; \mathbf{9,22(4)}; \; \mathbf{r}_3; \; \mathbf{5,02(5)}; \; \mathbf{r}_4; \; \mathbf{9,59(8)}; \\ \mathbf{r}_5; \; \mathbf{6,35(3)}; \; \mathbf{J}_{1-2} = \mathbf{3,6Hz}; \; \mathbf{J_{S1HC1-CH}}_2 = \mathbf{3,15Hz} \\ \mathbf{J}_{8-4} = \mathbf{4,5 \; Hz} \end{array}$
[32]	$^{1}_{\text{ClH}_{1}\text{Si}} - ^{2}_{\text{CH}_{2}} - ^{3}_{\text{SiH}_{2}} - ^{4}_{\text{CH}_{2}} - ^{5}_{\text{SiH}_{2}\text{Cl}}$	$ au_1 = au_5$: 5,22(3); $ au_2 = au_6$: 9,53(9); $ au_3$: 5,97(5) $ ext{J}_{\text{S1H}_2\text{C1}-\text{CH}_2} = 3,6 \text{ Hz}$; $ ext{J}_{\text{S1H}_2-\text{CH}_2} = 4,2 \text{ Hz}$
[34]	$\mathbf{H}_{3}\mathbf{Si} - \mathbf{CHCl} - \mathbf{SiH}_{2} - \mathbf{CHCl} - \mathbf{SiH}_{3}$	$ au_1 = au_5$: 6.04(2) $ au_2 = au_4$: 7.00(6) $ au_3 \sim 5.8$; $ extbf{J}_{\mathrm{SiH}_2-\mathrm{CHCl}} = 3.7 \; \mathrm{Hz}$; $ extbf{J}_{\mathrm{SiH}_2-\mathrm{CHCl}} = 3.5 \; \mathrm{Hz}$
[39]	$\begin{array}{c} \overset{1}{\text{Hcl}} \\ \overset{6}{\text{H}_2\text{C}} \overset{\text{Si}}{\text{CH}_3} \\ \overset{5}{\text{H}_2\text{Si}} \overset{\text{ }}{\underset{\text{ }}{\text{ }}} \overset{3}{\text{SiH}_2} \\ \overset{1}{\text{H}_2} \end{array}$	$ τ_1$: 4,92(5), $J \sim 2.8$ Hz; $τ_2 = τ_6$: 9,61(4); $τ_3 = τ_5$: 5,87(5), $J = 3.6$ Hz; $τ_4$: 9,96(5), $J = 3.6$ Hz
[40]	$\begin{array}{c c} \overset{\overset{\cdot}{\mathbf{H}_{2}}}{\overset{\cdot}{\mathbf{H}_{2}}}\\ \overset{\circ}{\mathbf{H}_{2}}\mathbf{C} & \overset{\circ}{\mathbf{CH}_{2}}\\ \overset{\circ}{\mathbf{H}_{2}}\mathbf{S}i & & & \\ \overset{\circ}{\mathbf{H}_{2}}\mathbf{S}i & & \\ \end{array}$	τ_1 : 5,85(5), J \sim 3,6 Hz; $\tau_2 = \tau_6$: 9,53; $\tau_3 = \tau_5$: 4,82(5); J \sim 2,4 Hz τ_4 : 9,25(3), J \sim 2,4 Hz
[44]	$\overset{1}{\mathbf{H}_{\mathfrak{s}}}\mathbf{Si} - \overset{2}{\mathbf{CHCl}} - \overset{3}{\mathbf{SiH}_{\mathfrak{s}}}\mathbf{Cl}$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

a) Gemessen mit TMS ($\tau = 10,00$) als innerer Standard in CCl₄. [1], [3], [4], [10], [13], [17], [19], [23] als reine Substanz, die übrigen im Gemisch ihrer Reaktionspartner, Zahlen in den Klammern () geben die Multiplizität des Resonanzsignals an.

b) Bei höchster Auflösung weitere Aufspaltung durch Fernkopplung. PMR-Daten der Verbindungen [14] (H₂Si)₂CHC!, [16] H₂Si-CCl₂-SiH₂-CH₂-SiH₃, [21] (H₃Si)₂CH₃, [22] (H₃Si)₂CCl₂, [28] (H₃Si-CH₂)₃SiH₃, [33] H₄Si-CHCl-SiH₂-CCl₂-SiH₃, [35] (H₂Si-CCl₂)₂SiH₂, [36] (H₂Si-CH₂)₃, Lit. ¹⁰).

V. Experimentelle Einzelheiten

1. Chlorierungen

a) Die Photochlorierung der Verbindungen [1], [2] und [3] erfolgte in N₂-Atmosphäre. Der Reaktionsablauf wurde über die PMR-Spektren kontrolliert und die Chlorierung so lange fortgesetzt, bis keine CH-Resonanzen mehr zu erkennen waren; Lösungsmittel CCl₄.

(Cl₃Si)₂CCl₂[20]: Sdp. 96-97°C, 13 Torr: 300 g von [1] wurden ohne Lösungsmittel durch UV-Bestrahlung und Einleiten von Chlor bei 80°C chloriert. Aufarbeitung des Reaktionsproduktes durch Destillation. Hauptfraktion 96-97°C, 13 Torr; isoliert 200 g von Verbindung [20].

(Cl₃Si—CCl₂)₂SiCl₂ [9]: 286 g von (Cl₃Si—CH₂)₂SiCl₂ [2] in 960 g CCl₄ wurden mit einer Hg-Lampe 135 Std. belichtet (Verschwinden aller CH-Protonen) und nach beendeter Chlorierung Lösungsmittel und alle flüchtigen Teile im Ölpumpenvakuum bis 70°C abgezogen. Die zähflüssige Verbindung [9] ist nicht unzersetzt destillierbar. Durch Umsetzung mit LiAlH₄ entsteht (H₃Si—CCl₂)₂SiH₂.

(Cl₂Si—CCl₂)₃[12]: 56 g von (Cl₂Si—CH₂)₃ [3] in 500 ml CCl₄ werden unter UV-Bestrahlung bei 70°C chloriert. Nach 90 Std. ist die Chlor-Aufnahme beendet (keine CH-Protonen im PMR-Spektrum). Nach Entfernen des Lösungsmittels durch Destillation und Kondensation im Vakuum bleibt ein brauner kristalliner Rückstand, der in Pentan umzukristallisieren ist, wobei weiße Kristalle resultieren. Ausbeute an [12] 80%.

Der Ablauf der Chlorierungsreaktion läßt sich im PMR-Spektrum verfolgen und nach der Chlorierung einer CH₂-Gruppe abbrechen (PMR-Spektrum Resonanzlinie bei 96 Hz). Es ist dann Verbindung [10] nach Umkristallisieren aus Pentan als weiße kristalline Substanz zu isolieren. 3,54 g von [10] werden in 26 ml Äther gelöst und mit 0,8 g LiAlH₄ in 20 ml Äther bei 0°C umgesetzt und anschließend 2 Std. im auftauenden Eisbad und 1 Std. bei Raumtemperatur gerührt. Danach wurden alle flüchtigen Produkte im Ölpumpenvakuum bei 20°C in eine mit fl. N₂ gekühlte Falle kondensiert und anschließend fraktioniert aufgetrennt (verschiedene Kühlbäder). Nach Entfernen des Äthers verbleibt bei einer Badtemperatur von —22,9°C (schmelzendes CCl₄) 1 g von [17] (reine Verbindung) in der Falle.

4,7 g (0,01 Mol) von [13] werden in 20 ml n-Butyläther vorgelegt und bei Eiskühlung 0,63 g (0,01 Mol) LiAlH₄ (gelöst in 20 ml n-Butyläther) innerhalb 2 Std. zugetropft. Nach Auftauen und Entfernen des Äthers (Abkondensieren) sublimiert [19] in der Apparatur¹⁰); Ausbeute 2,5 g (92%).

b) Chlorierung mit SO₂Cl₂

(Cl₃Si—CH₂)₂SiCl₂[2] zu [5] und [6]: 14,4 g von [2] (36,4 mMol) wurden mit 20 g SO₂Cl₂ (148 mMol) in einem 100 ml Zweihalskolben (CaCl₂-Rohr, Magnetrührer, Ölbad, Stickstoff-Atmosphäre) bis zum Sieden des Chlorierungsmittels erwärmt und dann 100 ml Dibenzoylperoxid zugesetzt. Die Zugabe des Katalysators wurde nach 6 und weiteren 16 Std. wiederholt und anschließend das Gemisch weitere 9 Std. im Sieden gehalten.

Das unverbrauchte SO_2Cl_2 (6 g = 44,5 mMol) wurde im Vakuum bei 20°C abgezogen. Im Reaktionsgemisch waren die Verbindungen [2] mit 41%, [5] mit 25% und [6] mit 34% (ermittelt aus dem PMR-Spektrum) vorhanden. Bei der anschließenden Destillation im Ölpumpenvakuum war eine Anreicherung der einzelnen Verbindungen zu erreichen. Zwischen 67-74°C (Fraktion 1) ging ein Gemisch aus gleichen Anteilen von [5] und [6] mit geringen Mengen der Ausgangsverbindung [2] über, während Fraktion [2] (78-80°C) Verbindung [6] als Hauptanteil enthielt.

Fraktion 1 und 2 wurden zur Bildung der SiH-haltigen Verbindung [15] und [16] mit LiAlH₄ umgesetzt, wozu das in Äther gelöste Chlorsilan auf die ätherische Lösung von LiAlH₄ bei 0°C zugetropft, 3 Std. bei Eiskühlung und eine weitere Std. bei 20°C gerührt wurde. Alle flüchtigen Verbindungen ließen sich über Kondensationen abtrennen bzw. anreichern. Nach der Abtrennung des Äthers aus einem Bad bei —78°C erfolgte die von (H₃Si—CH₂)₂SiH₂ [28] aus einem Chlorbenzol-Bad (—45,2°C) in die mit flüssigem N₂ gekühlte Falle. Im Bad bei —45,2°C verblieben die Verbindungen [15] und [16], die nicht vollständig aufzutrennen waren, sondern lediglich durch Umfraktionierung weiter angereichert werden konnten. Ansätze: 1. Fraktion 1,7 g in 5 ml Diäthyläther mit 0,5 g LiAlH₄ in 10 ml Diäthyläther. Erhalten wurden 0,5 g des Gemisches der Verbindung [15] und [16].

2. Fraktion. $3.5 \,\mathrm{g}$ in 6 ml Diäthyläther mit $0.8 \,\mathrm{g}$ LiAl H_4 in 20 ml Diäthyläther; erhalten wurden $1.1 \,\mathrm{g}$ des Gemisches der Verbindung [15] und [16].

(Cl.Si—CH₂)₃ [3] zu [10] und [11]: 9.8 g (28.9 mMol) von [3] in 25 ml CCl₄ wurden mit 8,1 g (60 mMol) SO₂Cl₂ zum Sieden erhitzt und mit 100 g Dibenzoylperoxid versetzt, das Reaktionsgemisch 17 Std. auf dem Rückfluß gekocht und während dieser Zeit in Abständen von 6 und 12 Std. je 100 g des Katalysators zugesetzt. Nach Abdestillieren vom Lösungsmittel und restlichem SO₂Cl₂ (Vakuum) verblieb ein Kristallbrei, der sich vollständig in Pentan löst. Aus dem PMR-Spektrum des Reaktionsgemisches ergeben sich folgende Anteile in Gew.-%: Verbindung [3] (50%), [11] (34%), [10] (16%). Das Reaktionsgemisch wurde anschließend zur Bildung der Verbindungen [17] und [18] mit LiAlH4 umgesetzt. Dazu wurden 9,7 gein 20 ml Diäthyläther zu 1,65 g LiAlH, in 20 ml Diäthyläther unter Eiskühlung zur Reaktion g bracht; die LiAlH₄ Menge reichte nicht zur vollständigen Reduktion der CCI-Gruppen aus. Nach 4-stündiger Umsetzungszeit im Eisbad wurden alle flüchtigen Verbindungen im Vakuum abdestilliert und die Reaktionsprodukte im Fraktionsteil der Apparatur¹⁰) aufgetrennt. Nach 48 Std. war aus dem Eis-Kochsalzbad (-18° C) in die mit flüssigem N_2 gefüllte Falle 1,6 g $(H_2Si-CH_2)_3$ mit Anteilen von [18] übergegangen. Die im Bad verbleibende Substanz wurde bei 0°C weiter getrennt; nach 4 Std. waren weitere 1,6 g des Gemisches aus den Verbindungen [18] und [17] abdestilliert. Im Eisbad verblieben 0,7 g unvollständig reduzierte Derivate von [3] und [11] (2 SiCl₂-, 1 SiH₂-Gruppen) neben Verbindung [17]. Die beiden letzten Fraktionen wurden erneut mit LiAlH₄ umgesetzt, um die noch vorhandenen SiCl₂-Gruppen zu hydrieren (2,1 g in 5 ml Diäthyläther kamen mit 135 mg LiAl H_A in 5 ml Diäthyläther zur Reaktion). Die Aufarbeitung erfolgte wie im vorausgegangenen Fall. Es wurden 0,45 g von [36] und 1,0 g eines Gemisches von [18] und [17] im Molverhältnis 6:4 erhalten. Nach Abschätzen der Ausbeuten sind bei der Aufarbeitung 70-80% der SiCl-haltigen Verbindung erfaßt worden, so daß bei der Chlorierungsreaktion keine größeren Anteile der perchlorierten Verbindung (Cl₂Si—CCl₂)₃ [12] entstehen.

2. Austauschreaktionen

Die Umsetzungen wurden in Reaktionsgefäßen ($110-170\,\mathrm{ml}$; Magnetstäbehen zum Rühren) mit zwei Zerschlageventilen und einem Schliff (mit Abschmelzstelle) vorgenommen. Das sehwer flüchtige, perchlorierte Carbosilan wurde über den Schliff eingefüllt (Glastrichter, sauberhalten der Abschmelzstelle), das Gefäß anschließend über den Schliff mit der Vakuumapparatur verbunden, die Substanz eingefroren (fl. N_2), evakuiert, die berechnete Menge des perhydrierten Carbosilans aufkondensiert, das Reaktionsgefäß abgeschmolzen und die Umsetzung unter Rühren bei 20°C begonnen und im Ölbad weitergeführt. Die Umsetzungen laufen auch dann ab, wenn die bei dem folgenden Beispiel angegebenen Temperaturen und Reaktionszeiten nicht streng eingehalten werden. Nach Beendigung der Umsetzung wird das Verbindungsgemisch im fl. N_2 kondensiert, das Reaktionsgefäß über den

Ansatz am Zerschlageventil mit der Vakuumapparatur verschmolzen, das Ventil zerschlagen und das Reaktionsgemisch aufgetrennt. Der flüchtige und durch Destillation abzutrennende Anteil besteht aus den SiHCl-haltigen Verbindungen. Die im Rückstand verbleibenden Verbindungen sind die C-chlorierten, SiCl-haltigen Carbosilane, die zur Identifizierung mit LiAlH_4 eingesetzt werden ($\equiv \text{SiCl} \rightarrow \equiv \text{SiH}$).

(Cl₃Si)₂CCl₂ [20] mit (H₃Si)₂CH₂ [21]: Ansatz 9,92g (28,2 mMol) von [20] mit 1,43 g (18,8 mMol) von [21], Reaktionszeit: 3 Tage bei 20°C; 5 Tage bei 42°C, 10 Tage bei 60°C stets unter Rühren.

SiHCl-haltige Derivate [23] bis [27]: Bei der Fraktionierung wurden 200 mg (H_3 Si)₂CH₂ [21] [Bad von -95° C (Toluol)] abgetrennt. Es waren keine weiteren flüchtigen Anteile vorhanden. Im Bad (-95° C) verblieb ein Gemisch, das bei $-63,5^{\circ}$ (Chloroform) getrennt wurde, wobei 1 g H_2 ClSi $-CH_2$ SiH₃ [23] zu erhalten war.

Die bei -63.5°C im Bad verbleibende Substanz ließ sich nicht mehr weiter auftrennen (1 g). Sie besteht hauptsächlich aus H_2 ClSi $-CH_2-SiH_2$ Cl [24]. Als weitere Produkte sind im PMR-Spektrum die Verbindungen H_3 Si $-CH_2-SiHCl_2$ [25], H_2 ClSi $-CH_2-SiCl_2H$ [26] und HCl_2 Si $-CH_2-SiCl_2H$ [27] zu erkennen; Molgewichtsbest. über Dampfdichte ergab 145 und 149, ber. f. Verb. [24], 145, von der etwa 0,7 g im Gemisch vorhanden sind.

CCl-haltige Derivate:

Der nicht flüchtige Reaktionsrückstand enthielt $(Cl_3Si)_2CHC[4]$ als Hauptprodukt neben $(Cl_3Si)_2CH_2[1]$ und nicht umgesetztem [20] und wurde mit LiAlH₄ reduziert. Ansatz: 6,9 g in 15 ml Dibutyläther mit 1,6 g LiAlH₄ in 25 ml Dibutyläther. Nach Zutropfen des Chlorsilans in die LiAlH₄-Suspension (gekühlt mit Eiswasser) wurde $4^1/_2$ Std. bei Raumtemperatur gerührt, dann alle flüchtigen Produkte abkondensiert und entsprechend der Isolierung von $(H_3Si)_2CCl_2[22]$ fraktioniert¹⁰). Dabei verblieb der Dibutyläther im Kühlbad $-35\,^{\circ}$ C (Dichloräthan), 2,4 mg SiH₄ wurden abgetrennt und aus dem auf $-95\,^{\circ}$ C gekühlten Bad (Toluol) wurden $90\,\text{mg}$ $(H_3Si)_2CH_2[21]$ erhalten; es verblieben 1,75 g eines Gemisches aus $(H_3Si)_2CHCl[14]$ $(1,2\,\text{g})$ und $(H_3Si)_2CCl_2[22]$ $(0,55\,\text{g})$ (Anteile bestimmt aus PMR-Spektrum).

(Cl₃Si—CCl₂)₂SiCl₂ [9] mit (H_3 Si—C H_2)₂Si H_2 [28]: Ansatz: 11,4 g (21,4 mMol) [9] und 2,68 g (22,3 mMol) von [28], Reaktionszeiten: 10 Tage bei 95°C unter Rühren. 1,0 g nicht umgesetztes [28] waren aus dem Bad bei -45,2°C (Chlorbenzol) herauszudestillieren (Fraktion 1). Bei -22°C (CCl₄-Bad) wurden 1,45 g des Gemisches der Verbindungen [29] und [30] abgetrennt. Im Bad verblieben etwa 0,5 g der Verbindung [31] und [32] (Fraktion 2). Für die PMR- und massenspektrometrische Untersuchung wurden aus Fraktion 1 die leichterflüchtigen und aus Fraktion 2 die schwererflüchtigen Anteile verwendet.

Die CCl-haltigen Derivate [5] bis [8].

Der nicht flüchtige Rückstand enthält [7] als Hauptprodukt neben [5], [6], [8] und nicht umgesetzter Ausgangsverbindung [9]. Um die Verbindungen zu identifizieren, wurde mit LiAlH₄ umgesetzt. Ansatz: 9,6 g in 15 ml Diäthyläther mit 1,76 g LiAlH₄ in 20 ml Diäthyläther, Reaktionstemperatur —4°C. Das Reduktionsgemisch (ziegelrot) wurde nach dem Eintropfen (innerhalb 35 Minuten) 3 Std. im langsam auftauenden Eisbad gerührt. Nach Abkondensieren der gebildeten flüchtigen Verbindungen verblieb ein gelber Rückstand. Aus den flüchtigen Verbindungen wurden Äther und gebildetes SiH₄ (56 mg) entfernt. Aus dem verbleibenden Substanzgemisch (gekühlt mit schmelzendem Chlorbenzol) wurden 0,2 g (H₃Si-CH₂)₂SiH₂ [28] (aus [31] und [32] gebildet) und 0,15 g (H₃Si)₂CCl₂ [22] abkondensiert. Die weitere Fraktionierung erfolgte über ein Bad bei —22,9°C, das 0,3 g eines Gemisches aus den Verbindungen [15], [16], [34] passieren ließ und in dem 1,43 g eines Gemisches der Verbindungen [33], [35], [34] und [16] verblieb. Aus der Integration der PMR-

Spektren ergeben sich für die Zusammensetzung folgende Mol-%-Werte: [35] (26%), [33] (52%), [34] (10%), [16] (12%). Bei der weiteren Auftrennung verblieben im Eisbad Verbindung [35] und [33] im Verhältnis 1:1, im Bad von $-22,9^{\circ}$ (CCl₄) [35] und [33] im Verhältnis 1:3 und aus dem Bad von $22,4^{\circ}$ C kondensierten hauptsächlich die Verbindungen [34] und [16].

(Cl₃Si—CCl₂)₂SiCl₂ [9] mit (H₃Si)₂CH₂ [21]. Ansatz: 5,18 g (9,7 mMol) von [9] mit 0,8 g (10,5 mMol) von [21] in 5 ml Benzol; Reaktionszeit 2 Tage unter Rühren bei Raumtemperatur; 5 Tage bei 53°C). Abgetrennte Verbindungen: 550 mg der Ausgangsverbindung [21] durch Destillation aus dem Kühlbad bei —95°C (Reinheit über PMR-Spektrum kontrolliert).

An Si-chlorierten Substanzen wurde nur $HCl_2Si-CH_2-SiH_3$ [23] nachgewiesen (PMR-Spektrum, Molgewicht 107,5, gef., ber. 110,5). Die Trennung vom Lösungsmittel Benzol erfolgte über ein Bad bei $-63.5^{\circ}C$. Auf den Rückstand wurden nochmals 1,47 g (H_3Si) $_2CH_2$ [21] (19,3 mMol) kondensiert. Die Reaktion wurde 21 Tage bei 70°C geführt. Dabei setzten sich nochmals 180 mg [21] um, die zu $H_2ClSi-CH_2-SiH_3$ [23] und in geringem Anteil zu (H_2ClSi) $_2CH_2$ [24] chloriert wurden. Der nicht kondensierbare Rückstand enthält [7] als Hauptanteil und wurde mit LiAl H_4 umgesetzt: Ansatz 4,6 g in 7,5 ml Diäthyläther mit 0,8 g LiAl H_4 in 17 ml Diäthyläther. Während der Reaktion färbte sich das Gemisch ziegelrot. Bei der fraktionierten Kondensation verließen die Verbindungen (H_3Si) $_2CCl_2$ [22], [15], [16] und [34] die auf $-22.9^{\circ}C$ (CCl_4) gekühlte Falle (etwa 100 mg), während 1,2 g des Gemisches der Verbindungen [33] und [35] im Verhältnis 1:1 dort zurückgehalten wurden. Die Austauschreaktion ergibt einen Verbrauch von 430 mg (H_3Si) $_2CH_2$, das überwiegend zu $H_2ClSi-CH_2-SiH_3$ chloriert wurde.

(Cl₂Si—CCl₂)₃ [12] mit (H₃Si—CH₂)₂SiH₂ [28]. a) Ansatz: 7,02 g (12,85 mMol) von [12] mit 4,78 g (39,8 mMol) von [28]; Reaktionszeit 5 Tage bei 80°C und 18 Tage bei 85°C unter Rühren. Es wurden 0,25 g nicht umgesetztes [28] und 5,9 g Chlorierungsprodukt erhalten, das als Hauptbestandteil Verbindung [31] enthielt. Fraktionsrückstand bestand im wesentlichen aus dem kristallinen (Cl₂Si—CH₂)₃ [3]. Die Reduktion mit LiAlH₄ (5,1 g Reaktionsrückstand, 18 ml Diäthyläther, 1 g LiAlH₄ in 10 ml Diäthyläther) ergab 1,85 g des reduzierten Gemisches, das aus (H₂Si—CH₂)₃ [36] (90%) und (H₃Si—CH₂)₂SiH₂ [28] 10% bestand.

b) Ansatz: 4,5 g (8,25 mMol) [12] mit 1,49 g (12,4 mMol) [28] ohne Lösungsmittel 1 Tag bei 45°C, anschließend 5 Tage bei 60–65°C, 1 Tag bei 80°C, 4 Tage bei 95–98°C gerührt ([12] löst sich beim Erwärmen). Es entstehen keine gasförmigen Produkte. Trennung des Reaktionsgemisches durch Kondensation (Apparatur⁹)); Kondensat: 2,85 g flüssiger und kristalliner Produkte: Verbindungen ($\text{Cl}_2\text{Si}-\text{CH}_2$)₃[3] und [11] sowie $\text{H}_2\text{ClSi}-\text{CH}_2$ –Si $\text{HCl}_2-\text{Si}+\text{Cl}_2$ [37] und ($\text{HCl}_2\text{Si}-\text{CH}_2$)₂SiHCl[38].

Rückstand: 2,2 g; [11], [3], [10] sowie CHCl-haltige Derivate.

Bei der Umsetzung wird [28] fast vollständig verbraucht und 3-5 mal chloriert, wobei [37] Hauptprodukt wird. Aus [12] bilden sich [3], [11] und geringe Anteile [10].

(Cl₂Si—CCl₂)₃ [12] mit (\mathbf{H}_2 Si—C \mathbf{H}_2)₃ [36]. a) Umsetzung im Molverhältnis 1:1,1, Ansatz: 10,0 g (18,3 mMol) von [12] mit 2,71 g (20,5 mMol) von [36], 20 ml Benzol; Reaktionszeit 1 Tag bei Raumtemperatur, 21 Tage bei 75—90°C unter Rühren.

SiHCl-haltige Derivate [39] und [40).

Nach Abtrennung des Benzols wurden 0,1 g eines Gemisches aus [36] mit Anteilen von [39] aus einem Bad bei -22.9° C (CCl₄) abdestilliert; es verblieben die Verbindungen [39] und [40] sowie Reste von [36]; (2,5g). 0,6g von [40] verblieben im Rückstand. Aus der Interpretation der PMR-Spektren und dem Gewicht der Fraktionen ergibt sich für die Um-

setzung folgende Bilanz: [39] 1,8 g; [40] 1,25 g. 5,5% des eingesetzten $(H_2Si-CH_2)_3$ [36] wurden zurückerhalten; 63% des umgesetzten [36] in [39] und 37% in [40] überführt.

CCl-haltige Derivate [41] bis [43].

Der Reaktionsrückstand (zähflüssiger Kristallbrei) wurde zur Identifizierung mit LiAlH₄ umgesetzt. Ansatz: 9,2 g des Gemisches in 18 ml Diäthyläther mit 1,45 g LiAlH₄ in 15 ml Diäthyläther bei -5°C, Eintropfzeit 30 Min. und anschließend 4 Std. im auftauenden Eisbad gerührt. Aus dem Reaktionsgemisch wurden 0,4 g (H₂Si-CH₂)₃ [36] (aus [40]) nach Abtrennen des Äthers direkt abkondensiert, das verbleibende Reaktionsgemisch mehrmals mit Pentan extrahiert; als Rückstand verblieben nicht umgesetztes LiAlH₄, LiCl und Anteile des AlCl₃-Ätherates. Die weitere Aufarbeitung erfolgte in der früher angegebenen Sublimationsapparatur¹⁰). Nach Entfernen des Pentans kondensieren an dem mit flüssigem N₂ gekühlten Glasfinger die SiH-haltigen Verbindungen mit Anteilen der AlCl₃-Addukte. Im Kolben verbleiben im wesentlichen die AlCl₃-Addukte. Nach 6-maliger Wiederholung des Reinigungsvorganges wurden 2,25 g eines Gemisches aus (H₂Si-CCl₂)₃¹⁰) mit weiteren SiH₂-haltigen Derivaten mit CHCl und CH₂-Gruppen isoliert. Aus diesen wurden durch weitere Kondensation im Vakuum Verbindungen mit CHCl- und CH₂-Gruppen von dem wenigen (H₂Si-CCl₂)₃ und dem restlichen AlCl₃-Äther-Addukten abgetrennt.

b) Umsetzung im Molverhältnis 1:1,5. Ansatz: 8 g (14,6 mMol) [12] mit 2,9 g (22 mMol) [36] werden 1 Tag bei 45°C, 3 Tage bei 60°C und 9 Tage bei 95°C gerührt ([12] löst sich vollständig beim Erwärmen). Es entstehen keine gasförmigen Verbindungen und es verbleiben etwa 0,5 g nicht umgesetztes [36]. Die Trennung des Reaktionsgemisches erfolgt durch Sublimation (Kühlfinger flüssiger N₂; Ölbad 45°C). Als Kondensat wurden 4,75 g eines teils flüssigen, teils kristallinen Gemisches aus (Cl₂Si—CH₂)₃ [3] und Derivaten von [36] mit drei bis fünf SiCl-Gruppen erhalten. Als kristalliner Rückstand blieb hauptsächlich (Cl₂Si—CH₂)₃ [3] (5,5 g) und keine CHCl-haltigen Verbindungen, so daß die Hydrierung der CCl₂-Gruppen von [12] vollständig verlaufen ist.

Dem Fonds der Chemischen Industrie, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Volkswagen-Stiftung und den Farbenfabriken Bayer danken wir für die Unterstützung unserer Untersuchung, Herrn Dr. Scheer für die massenspektrometrischen Messungen und Herrn Domnick für die PMR-Messungen.

Karlsruhe, Institut für Anorganische Chemie der Universität (TH).

Bei der Redaktion eingegangen am 3. Dezember 1970.

Anschr. d. Verf.: Prof. Dr. G. Fritz und Dr. H. Fröhlich Inst. f. Anorgan. Chemie der Universität Karlsruhe BRD-75 Karlsruhe, Englerstr. 11